



باب چودہ

نیم موصل الکٹرانیات: مادے، آلات اور سادہ سرکٹ

(SEMICONDUCTOR ELECTRONICS: MATERIALS, DEVICES AND SIMPLE CIRCUITS)

14.1 تعارف (INTRODUCTION)

وہ آلات جن میں الکیٹرانوں کا قابو شدہ بہاؤ حاصل کیا جاسکتا ہے، تمام الکیٹرانک سرکٹوں کے بنیادی اجزاء ترکیبی ہیں۔ 1948ء میں ٹرانسٹر کی ایجاد سے پہلے، ایسے آلات، زیادہ تر خلائی ٹلیاں (vacuum tubes) تھیں [جو والوں (valves) بھی کہلاتی تھیں] جیسے خلائی ڈایوڈ، جس میں دو بر قیرہ ہوتے ہیں، یعنی کہ، مبینہ (جسے اکثر پلیٹ بھی کہا جاتا ہے) اور منفیرہ، ٹریوڈ، جس میں تین بر قیرہ ہوتے ہیں — منفیرہ، پلیٹ اور گردہ، ٹریوڈ اور پینٹوڈ (باتریب 4 اور 5 بر قیروں پر مشتمل)۔ ایک خلائی نی میں ایک گرم کیے گئے منفیرہ کے ذریعے الکیٹران مہیا کیے جاتے ہیں اور ان الکیٹرانوں کا خلائی قابو شدہ بہاؤ، اس کے مختلف بر قیروں کے درمیان ولٹیج تبدیل کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ بر قیروں کی درمیانی جگہ میں خلا چاہیے ہوتا ہے، ورنہ حرکت کرتے ہوئے الکیٹران اپنے رستے میں آنے والے ہوا کے ملکیوں سے تصادم کر کے اپنی توانائی ضائع کر سکتے ہیں۔ ان آلات میں، الکیٹران صرف منفیرہ سے متینہ تک بہہ سکتے ہیں (یعنی کہ صرف ایک سمت میں)۔ اسی لیے ایسے آلات کو عام طور سے والوں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خلائی نی آلات، زیادہ جگہ گھیرنے والے ہوتے ہیں، زیادہ پاور استعمال کرتے ہیں، عام طور سے اونچی ولٹیج (V ~ 100) پر کام کرتے ہیں اور ان کی زندگی مختصر ہوتی ہے اور زیادہ قابل بھروسہ بھی نہیں ہوتے۔ جدید ٹھوں۔ حالت نیم موصل

نیم موصل الکٹر انیات: مادے، آلات اور ساہہ سرکٹ

الیکٹر انیات کی بنیاد 1930 میں پڑی، جب پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا کہ کچھ ہوس۔ حالت نیم موصل اور ان کے جتناش ان میں سے گذر رہے ہے چارج برداروں (Charge carriers) کی تعداد اور ان کے بہاؤ کی سمت کو نظرول کر سکنے کا امکان مہیا کرتے ہیں۔ سادے اشتغال گر جیسے روشنی، حرارت یا خفیف اطلاقی ولٹیج وغیرہ ایک نیم موصل میں متحرک چار جوں کی تعداد تبدیل کر سکتے ہیں۔ نوٹ کریں کہ نیم موصل آلات میں چارج برداروں کی فراہمی اور چارج کا بہاؤ خود ہوس کے اندر ہی ہوتا ہے، جب کہ پرانی خلانیوں / والوں میں متحرک الیکٹران ایک گرم کیے گئے منفیرہ سے حاصل کیے جاتے تھے اور انھیں ایک خلا کی گئی جگہ یا خلامیں سے بھایا جاتا تھا۔ نیم موصل آلات کے لیے باہر سے حرارت مہیا کرنے یا خلا کی گئی بڑی جگہ فراہم کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ یہ سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں، مقابلاً بہت کم پاور استعمال کرتے ہیں، ادنیٰ ولٹیج پر کام کرتے ہیں اور ان کی زندگی لمبی ہوتی ہے اور زیادہ قابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر مانیٹروں میں استعمال کی جانے والی منفیرہ کرن ٹلیاں [(کیتوڈرے ٹوبز CRT)] کو بھی، جو خلائی نیوں کے اصول پر کام کرتی ہیں، رقیق کرستل نمائش [LCD] (liquid crystal display) مانیٹروں سے، مدگار ہوس حالت الیکٹر انیات کے ساتھ، تبدیل کیا جا رہا ہے۔ نیم موصل آلات کی باقاعدہ اہمیت کا احساس کیے جانے سے بہت پہلے ہی، ایک قدرتی طور پر پائے جانے والے کرستل گیلینیا (galena) (لیڈ سلفاٹ Pbs) سے ایک دھاتی نقطہ تماں مسلک کر کے اسے ریڈ یوہروں کو شناخت کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔

مندرجہ ذیل حصوں میں ہم نیم موصل طبیعت کے بنیادی تصورات کا تعارف پیش کریں گے اور کچھ نیم موصل آلات، جیسے جتناش ڈائیوڈ (ایک 2-بر قیرہ آلہ) اور دو قطبی جتناش ٹرانسیستر (ایک 3-بر قیرہ آلہ)، سے بحث کریں گے۔ ان کے اطلاق کی وضاحت کرنے والے چند سرکٹ بھی بیان کیے جائیں گے۔

14.2 دھاتوں، موصلوں اور نیم موصلوں کی درجہ بندی (CLASSIFICATION OF METALS, CONDUCTORS AND SEMICONDUCTORS)

الیصالیت کی بنیاد پر:

برقی الیصالیت (σ) یا مزاحمت $\rho = \frac{1}{\sigma}$ کی نسبتی قدروں کی بنیاد پر ہوس اشیا کی موٹے طور پر درجہ بندی کی جاسکتی ہے:

(i) دھاتیں (Metals): ان کی مزاحمت بہت کم ہوتی ہے۔ (یا الیصالیت زیادہ ہوتی ہے)

$$\rho \sim 10^{-2} - 10^{-8} \Omega m$$

$$\sigma \sim 10^2 - 10^8 S m^{-1}$$

(ii) نیم موصل (Semiconductors): ان کی مزاحمت یا الیصالیت، دھاتوں اور حاجزوں کے درمیان ہوتی ہے۔

$$\rho \sim 10^{-5} - 10^{+6} \Omega m$$

$$\sigma \sim 10^5 - 10^{-6} S m^{-1}$$

(iii) حاجز (Insulators): ان کی مزاحمت بہت زیادہ ہوتی ہے (یا الیصالیت بہت کم ہوتی ہے)

$$\rho \sim 10^{11} - 10^{19} \Omega m$$

$$\sigma \sim 10^{-11} - 10^{-19} S m^{-1}$$

ρ اور σ کی مندرجہ بالا قدریں صرف ان کی عددی قدر کی نشان دہی کرتی ہیں اور کچھ اشیا کے لیے ان کی قدر دی ہوئی سعت کے باہر بھی ہو سکتی ہے۔ مراجحت کی نسبتی مقداریں ہی صرف دھاتوں، حاصلہ موصلوں میں امتیاز کرنے کا واحد معیار نہیں ہیں۔ کچھ دیگر فرق بھی ہیں، جو اس باب میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ واضح ہوتے جائیں گے۔ اس باب میں ہماری دلچسپی ان نیم موصلوں کے مطالعے سے ہے جو ہو سکتے ہیں!

(i) عنصری نیم موصل: Ge اور Si

(ii) مرکب نیم موصل: مثالیں ہیں:

- غیر نامیاتی (inorganic): CdS, GaAs, CdSe, InP, وغیرہ
- نامیاتی (organic): پیتھر اسین، آمیزش شدہ (doped) پیتھا لوسیانانس وغیرہ
- نامیاتی پولیمر: پولی پائی رول، پولی اینی لائس، پولی تھائیوفن وغیرہ

آج کل جو نیم موصل دستیاب ہیں، ان میں سے زیادہ تر عنصری نیم موصل Si یا Ge اور مرکب غیر نامیاتی نیم موصل ہیں۔ لیکن 1990 کے بعد سے چند ایسے نیم موصل آلات تیار کیے گئے ہیں جن میں نامیاتی موصل اور نیم ایصالی پولیمر استعمال کیے گئے ہیں اور اس طرح پولیمر الیکٹرانیات اور مالکیوی الیکٹرانیات کی شروعات ہو گئی ہے جو مستقبل کی ٹیکنالوجی کی نشان دہی کرتی ہیں۔ اس باب میں ہم غیر نامیاتی نیم موصل، خاص طور پر عنصری نیم موصل Si اور Ge کے مطالعے تک محدود رہیں گے۔ یہاں عنصری نیم موصلوں سے بحث کرنے کے لیے متعارف کرائے گئے عمومی تصورات کا اطلاق بڑی حد تک زیادہ تر مرکب نیم موصلوں پر بھی ہوتا ہے۔

تو انائی بینڈس کی بنیاد پر:

بوہ رائٹی ماؤل کے مطابق، ایک جدا ایٹم میں، اس کے کسی بھی الیکٹران کی تو انائی اس مدار سے متعین ہوتی ہے جس میں وہ طواف کرتا ہے۔ لیکن جب ایک ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ٹھووس شے تشکیل کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے بہت نزدیک ہوتے ہیں۔ اس لیے پڑوستی ایٹموں کے باہری مدار ایک دوسرے کے بہت زیادہ نزدیک ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہم پوش (overlapping) بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ایک ٹھووس شے میں الیکٹران کی حرکت، ایک جدا ایٹم میں الیکٹران کی حرکت سے بہت مختلف ہو جاتی ہے۔

ایک کریٹل کے اندر ہر الیکٹران کا ایک کیتا (unique) مقام ہوتا ہے اور کہ ہی دو الیکٹرانوں کے ارد گرد چار جوں کا یکساں نمونہ نہیں پایا جاتا۔ اس وجہ سے، ہر الیکٹران کی مختلف تو انائی منزل ہوتی ہے۔ وہ تو انائی منازل، جن میں تو انائی کی مسلسل تبدیلی پائی جاتی ہے، تو انائی بینڈ تشکیل دیتے ہیں۔ وہ تو انائی بینڈ جس میں گرفت الیکٹرانوں (valence electrons) کی تو انائی منازل شامل ہوتی ہیں، گرفت بینڈ کہلاتے ہیں۔ گرفت بینڈ کے اوپر کا تو انائی بینڈ، ایصالی بینڈ (conduction band) کہلاتا ہے۔ اگر کوئی خارجی تو انائی مہیا نہ ہو تو تمام گرفت الیکٹران، گرفت بینڈ میں رہیں گے۔ اگر ایصالی بینڈ کی

چلی ترین منزل، گرفت بینڈ کی سب سے اوپری منزل سے نیچے ہوتا گرفت بینڈ کے الکٹران با آسانی ایصال بینڈ میں جاسکتے ہیں۔ عام طور سے ایصال بینڈ خالی ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ گرفت بینڈ سے ہم پوش ہوتا ہے تو الکٹران با آسانی اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ دھاتی موصلوں میں بھی صورت ہوتی ہے۔

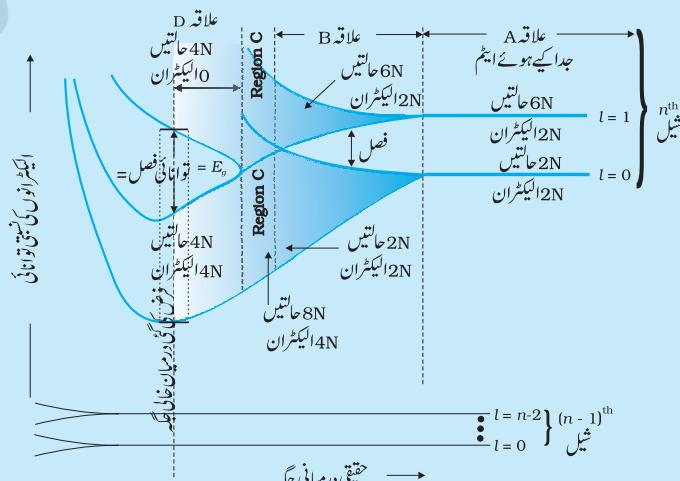
اگر ایصال بینڈ اور گرفت بینڈ کے درمیان کچھ فاصلہ (درمیانی خالی جگہ gap) ہوتا گرفت بینڈ کے تمام الکٹران بند ہے رہتے ہیں اور ایصال بینڈ میں کوئی آزاد الکٹران نہیں دستیاب ہوتا۔ اس طرح وہ مادی شے حاجز بن جاتی ہے۔ لیکن گرفت بینڈ کے کچھ الکٹران اتنی خارجی تو انائی حاصل کر سکتے ہیں کہ ایصال بینڈ اور گرفت بینڈ کے درمیانی فاصلے کو پار کر سکیں۔ تب یہ الکٹران ایصال بینڈ میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ گرفت بینڈ میں خالی تو انائی منازل پیدا کر دیں گے جہاں دوسرے گرفت الکٹران آسکتے ہیں۔ اس طرح اس عمل سے ایصال بینڈ میں الکٹرانوں کے ذریعے اور گرفت بینڈ میں خلو (vacancy) کے ذریعے ایصال کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔

آئیے دیکھیں کہ N ایٹموں کے ایک Si یا Ge کریسل میں کیا ہوتا ہے۔ Si کے لیے سب سے باہری مدار تیسرا مدار ($n=3$) ہے جب کہ Ge کے لیے یہ چوتھا مدار ($n=4$) ہے۔ سب سے باہری مدار میں الکٹرانوں کی تعداد 4 ہے ($2s+6p$ الکٹران)۔ اس لیے $4N$ گرفت الکٹرانوں کے لیے $8N$ دستیاب تو انائی حاlets ہیں۔ یہ $8N$ تو انائی منازل یا تو ایک مسلسل بینڈ تشکیل دے سکتے ہیں یا مختلف بینڈوں میں ان کے گروپ ہو سکتے ہیں، جس کا انحصار کریسل میں ایٹموں کے درمیانی فاصلے پر ہے (ٹھوس اشیا کے بینڈ نظریہ پر بارکس دیکھیے)

Si اور Ge کی کریسل جالی (کریسل لیس crystal lattice) میں ایٹموں کے درمیانی فاصلے پر ان $8N$ حالتوں کے تو انائی بینڈوں میں علاحدہ ہو جاتے ہیں، جن کے درمیان تو انائی فصل E_g ہوتی ہے (شکل 14.1)۔ نچلا بینڈ جو مطلق صفر درجہ حرارت پر $4N$ گرفت الکٹرانوں کے ذریعے مکمل طور پر گھرا ہوتا ہے، گرفت بینڈ ہے۔ دوسرا بینڈ، جو $4N$ تو انائی حالتوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ایصال بینڈ کھلاتا ہے، مطلق صفر پر پوری طرح خالی ہوتا ہے۔

ٹھوس اشیا کا بینڈ نظریہ (BAND THEORY OF SOLIDS)

مان لیجیے کہ Ge یا Si کریسل میں N ایٹم ہیں۔ ہر ایٹم کے الکٹرانوں کی مختلف مداروں میں مجرد تو انائیاں ہوں گی۔ اگر تمام ایٹم چدا جاؤں، یعنی ایک دوسرے سے طویل فاصلے پر ہوں تو الکٹران تو انائی یکساں ہو گی۔ لیکن ایک کریسل میں، ایٹم ایک دوسرے کے نزدیک ہوتے ہیں (2 \AA یا 3 \AA فاصلہ) اس لیے الکٹران ایک دوسرے سے اور پڑوی ایٹم قابوں سے باہم عمل کرتے ہیں۔ یہم پوشی (overlap) (یا باہم عمل) (or interaction) [وہ الکٹران زیادہ محسوس کرتے ہیں جو سب سے باہری مدار میں ہوتے ہیں، جب کہ انرونی مداروں یا قابل کے الکٹرانوں کی تو انائیاں غیر متاثر رہ سکتی ہیں۔ اس لیے Ge یا Si کریسل



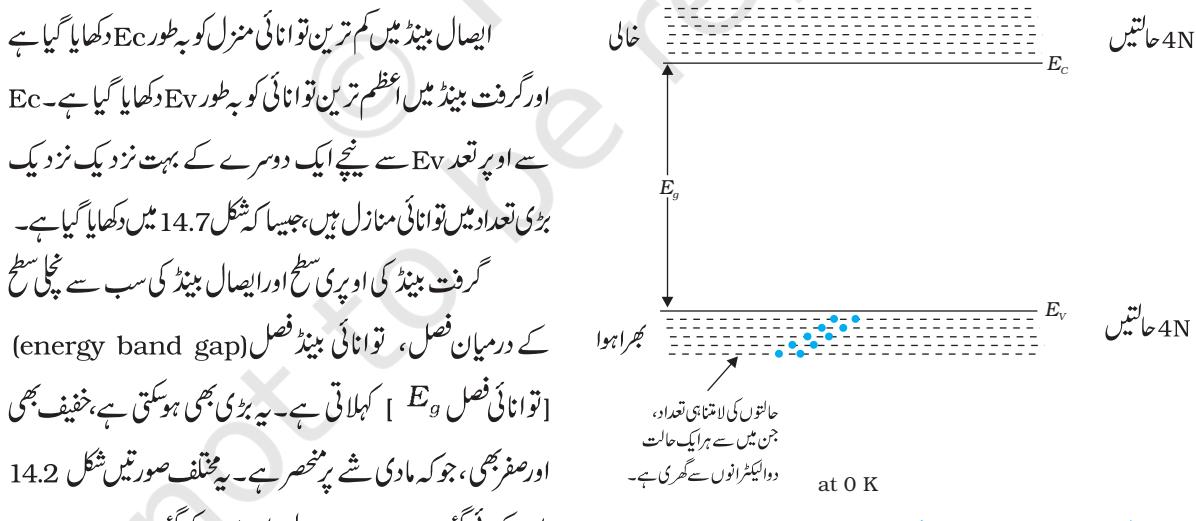
میں الکٹران تو انیوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف سب سے باہری مدار کے الکٹرانوں کی تو انیوں میں ہونے والی تبدیلیوں کو ہی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ Si کے لیے سب سے باہری مدار، تیسرا مدار ہے ($n=3$)، جب کہ Ge کے لیے یہ چوتھا مدار ہے ($n=4$)۔ سب سے باہری مدار میں الکٹرانوں کی تعداد 4 ہے (2s²) اور p₂ الکٹران) اس لیے کرٹل میں باہری الکٹرانوں کی کل تعداد N=4 ہے۔ ایک مدار میں باہری الکٹرانوں کی از جد ممکنہ تعداد 8 ہے۔ (2s²+6p₂ الکٹران)۔ اس لیے 4N میں سے 2N₂ الکٹران، 2N_& حالتوں میں (0=امراچ کوائم عدد) اور 2N_p الکٹران، p₆N₋ حالتوں میں دستیاب ہیں۔ ظاہر ہے کہ کچھ p-الکٹران حالتیں خالی ہیں، جیسا کہ شکل کے بالکل دائیں حصے میں دکھایا گیا ہے۔ یہ ایک دوسرے سے بخوبی الگ یا جدا ایٹموں کی صورت ہے [شکل کا A علاقہ]۔

فرض کیجیے کہ یہ ایٹم ایک ٹھوں شے تشکیل کرنے کے لیے ایک آنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے باہری مدار میں ان الکٹرانوں کی تو انیاں تبدیل ہو سکتی ہیں (بڑھ بھی سکتی ہیں اور کم بھی ہو سکتی ہیں)، جس کی وجہ مختلف ایٹموں کے الکٹرانوں کے ماہین باہمی عمل ہے۔ 1=N₆ حالتیں، جن کی آغازی شکل میں، جدا ایٹموں میں مقاوی تو انیاں تھیں، پھر جاتی ہیں اور ایک تو انی بینڈ تشکیل دیتی ہیں (شکل میں علاقہ B)۔ اسی طرح 0=N₂ حالتیں، جن کی جدا ایٹموں میں مقاوی تو انیاں تھیں، ایک دوسرے بینڈ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ (دھیان سے شکل کا علاقہ B دیکھیے)، جو کہ پہلے بینڈ سے ایک تو انی فصل کے ذریعے علاحدہ ہوتا ہے۔

اس سے بھی کم درمیانی فاصلے پر، پھر بھی ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے، جس میں بینڈ ایک دوسرے میں ختم (merge) ہو جاتے ہیں۔ کم ترین تو انی حالت جو اوپری اٹھی منزل سے علاحدہ ہوئی ہوتی ہے، مقابلاً پھلی اٹھی منزل کی بالائی حالت کے نیچے آ جاتی ہے۔ اس علاقے میں (شکل میں علاقہ C)، ایسی کوئی تو انی فصل نہیں ہوتی اور یہاں اوپری اور پھلی تو انی حالتیں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں۔

آخر میں، اگر ایٹموں کا درمیانی فاصلہ مزید کم ہو جائے تو تو انی بینڈ پھر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور ان کے درمیان تو انی فصل_g آ جاتی ہے (شکل میں علاقہ D)۔ دستیاب تو انی حالتوں کی کل تعداد 8N₈، دونوں بینڈوں کے درمیان دوبارہ تقسیم ہو جاتی ہے (نچلے اور اوپری تو انی بینڈوں میں سے ہر ایک میں 4N₄ حالتیں)۔ یہاں اہم نکتہ یہ ہے کہ نچلے بینڈ میں قطعی درست طور پر اتنی ہی حالتیں ہوتی ہیں (4N₄)، جتنے ایٹموں سے دستیاب گرفت الکٹران ہوتے ہیں۔ (4N₄)۔

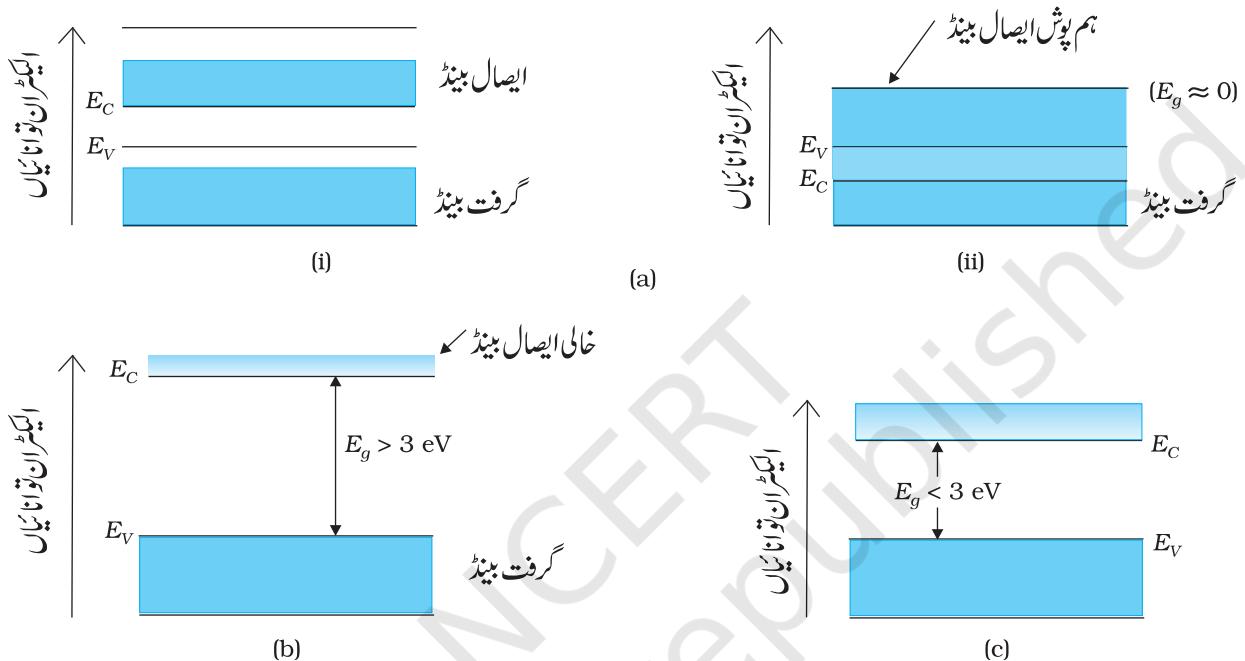
اس لیے، یہ بینڈ (جو گرفت بینڈ کہلاتا ہے) مکمل طور پر بھرا ہوتا ہے، جب کہ اوپری بینڈ مکمل طور پر خالی ہوتا ہے۔ یہ اوپری بینڈ ایصال بینڈ کہلاتا ہے۔



فہل 14.1: نیم موصل میں OK پر تو انی بینڈ مقامات۔ اوپری بینڈ، جو ایصال بینڈ کہلاتا ہے، ایک دوسرے کے قریب قریب تو انی حالتوں کی لامتناہی تعداد پر مشتمل ہوتا ہے۔ نچلا بینڈ، جو گرفت بینڈ کہلاتا ہے، ایک دوسرے کے قریب قریب مکمل طور پر بھری ہوئی، تو انی حالتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

جزوی طور پر بھرا ہوا اور گرفت بینڈ جزوی طور پر خالی ہو یا ایصال

بینڈ اور گرفت بینڈ ہم پوش ہوں۔ جب ہم پوشی پائی جاتی ہے تو گرفت بینڈ سے الکٹران با آسانی ایصال بینڈ میں جاسکتے ہیں۔ اس صورت میں برتنی ایصال کے لیے الکٹرانوں کی ایک بڑی تعداد ہمیا ہو جاتی ہے۔ جب گرفت بینڈ جزوی طور پر خالی ہوتا ہے تو اس کی پچھی منزل سے الکٹران مقابلتاً اوپری منزل میں جاسکتے ہیں اور اس طرح ایصال ممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسی مادی اشیاء کی مزاحمت کم ہوتی ہے اور ایصالیت کی قدر اعلیٰ ہوتی ہے۔



شکل 14.2: (a) دھاتوں (b) حاجزوں (c) نیم موصلوں کے تو انی بینڈوں کے درمیان فرق

صورت II: اس صورت میں، جیسا کہ شکل 14.2(b) میں دکھایا گیا ہے، ایک طویل بینڈ فصل E_g پائی جاتی ہے، $(E_g > 3 \text{ eV})$ ۔ ایصال بینڈ میں کوئی الکٹران نہیں ہوتا اور اس لیے ایصال بالکل ممکن نہیں ہوتا۔ نوٹ کریں کہ تو انی اتنی بڑی ہے کہ الکٹرانوں کو حرارتی اشتعال کے ذریعے گرفت بینڈ سے ایصال بینڈ میں منتقل نہیں کیا جاتا سکتا۔ یہ حاجزوں کی صورت ہے۔

صورت III: یہ صورت شکل (c) 14.2 میں دکھائی گئی ہے۔ یہاں ایک متناہی لیکن خفیف فصل پائی جاتی ہے $(E_g < 3 \text{ eV})$ ۔ خفیف بینڈ فصل کی وجہ سے، کمرہ درجہ حرارت پر، گرفت بینڈ کے کچھ الکٹران اتنی تو انی حاصل کر سکتے ہیں جو تو انی فصل کو عبور کرنے کے لیے کافی ہو اور ایصال بینڈ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ الکٹران (حالانکہ ان کی تعداد کم ہوتی ہے) ایصالی بینڈ میں آسکتے ہیں۔ اس لیے، نیم موصلوں کی مزاحمت اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی حاجزوں کی ہوتی ہے۔ اس حصے میں ہم نے دھاتوں، موصلوں اور نیم موصلوں کی موٹے طور پر درجہ بندی کی ہے۔ اگلے حصے میں آپ نیم موصلوں میں ہونے والے ایصالی عمل کے بارے میں سیکھیں گے۔

14.3 ذاتی نیم موصل (INTRINSIC SEMICONDUCTOR)

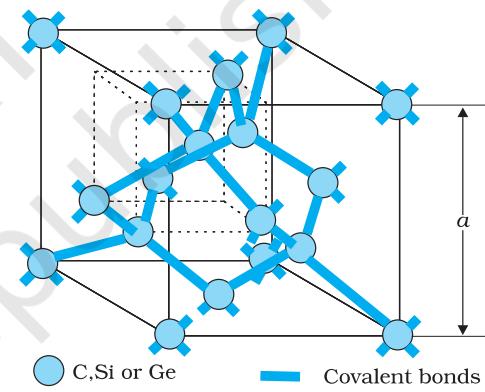
ہم Si اور Ge کی صورت لیتے ہیں، جو عام ترین صورت ہے اور جن کی لیٹس ساخت شکل 14.3 میں دکھائی گئی ہے۔ یہ ساختیں، ہیرے جیسی ساختیں کہلاتی ہیں۔ ہر ایٹم چار قریب ترین پڑوسیوں سے گھرا ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ Ge میں 4 گرفت الیکٹران ہوتے ہیں۔ اس کی قلمی ساخت میں اس کا ہر ایٹم اپنے چاروں پڑوی ایٹموں میں سے ہر ایک کو اپنے چاروں گرفت الیکٹرانوں میں سے ایک ایک الیکٹران بانٹتا ہے اور ہر پڑوی ایٹم سے ایک ایک الیکٹران کا حصہ لیتا ہے۔ یہ ساجھا کیے ہوئے الیکٹران جوڑے ایک شریک گرفت بند بتاتے ہیں۔ سادہ طور پر اسے گرفت بند بھی کہتے ہیں۔ دونوں بانٹے گئے الیکٹرانوں کو مانا جاسکتا ہے کہ وہ جن ایٹموں سے منسلک ہیں ان میں ایک سے دوسرے ایٹم پر آتے جاتے رہتے ہیں اور اس طرح انہیں مضبوطی سے باندھے رکھتے ہیں۔ شکل 14.4 میں شکل 14.3 میں دکھائی گئی ساخت کا 2-ابعادی اظہار دکھایا گیا ہے، جو شریک گرفت بند کو ضرورت سے زیادہ پر زد طریقے سے پیش کرتی ہے۔ اس میں ایک مثالی تصویر دکھائی گئی ہے، جس میں کوئی بند ٹوٹا نہیں ہے (اور تمام بند اپنی جگہ موجود ہیں)۔ اسی صورت تکلے درجات حرارت پر پیدا ہوتی ہے۔ جیسے جیسے درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ان الیکٹرانوں کو حرارتی تو انائی مہیا ہو جاتی ہے اور ان میں سے کچھ الیکٹران ٹوٹ کر باہر جاسکتے ہیں (آزاد الیکٹران بن سکتے ہیں اور ایصال میں حصہ لے سکتے ہیں)۔ حرارتی تو انائی موثر طور پر قلبی لیٹس میں چند ایٹموں کی ہی آئن سازی کرتی ہے اور بند میں ایک خلو (vacancy) پیدا کرتی ہے، جیسا کہ شکل 14.5(a) میں دکھایا گیا ہے۔ وہ پڑوس (آس پاس کام مقام) جہاں سے آزاد الیکٹران (جس کا چارنq+ ہے) باہر آیا ہے ایک خلو چوڑتا ہے جس کا موثر چارج (q+) ہے۔ یہ موثر ثابت الیکٹرانی چارج والا خلو، سوراخ (hole) کہلاتا ہے۔ سوراخ اس طرح برداشت کرتا ہے جیسے کہ وہ موثر ثابت چارج کا بظاہر آزاد رہ رہے۔

ذاتی نیم موصلوں میں، آزاد الیکٹرانوں کی تعداد n_e ، سوراخوں کی تعداد n_h کے مساوی ہوتی ہے۔ یعنی کہ

$$n_e = n_h = n_i \quad (14.1)$$

جہاں n_i ذاتی حامل ارتکاز (intrinsic carrier concentration) کہلاتی ہے۔

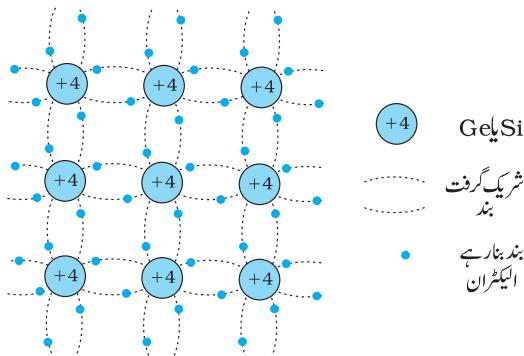
نیم موصلوں کی ایک کیتا خاصیت یہ ہے کہ ان میں الیکٹرانوں کے علاوہ، سوراخ بھی حرکت کرتے ہیں۔ فرض کیجیے کہ مقام پر ایک سوراخ ہے، جیسا کہ شکل 14.5(a) میں دکھایا گیا ہے۔ سوراخوں کی حرکت کا تصور، ہم اس طور پر کر سکتے ہیں، جیسا کہ شکل (b) 14.5 میں دکھایا گیا ہے۔ مقام 2 پر ایک شریک گرفت بند سے ایک الیکٹران خالی مقام 1 (سوراخ)



شکل 14.3: کاربن، سلی کون یا جرمیم کے لیے سے۔ ابعادی ہیرے۔ جیسی کرشل ساخت جس میں متطابق لیٹس درمیانی خالی جگہ، a ، 3.56، 5.43 اور \AA

ذاتی نیم موصلوں میں، آزاد الیکٹرانوں کی تعداد n_e ، سوراخوں کی تعداد n_h کے مساوی ہوتی ہے۔ یعنی کہ

نیم موصل الکٹر انیات: مادے، آلات اور سادہ سر کٹ

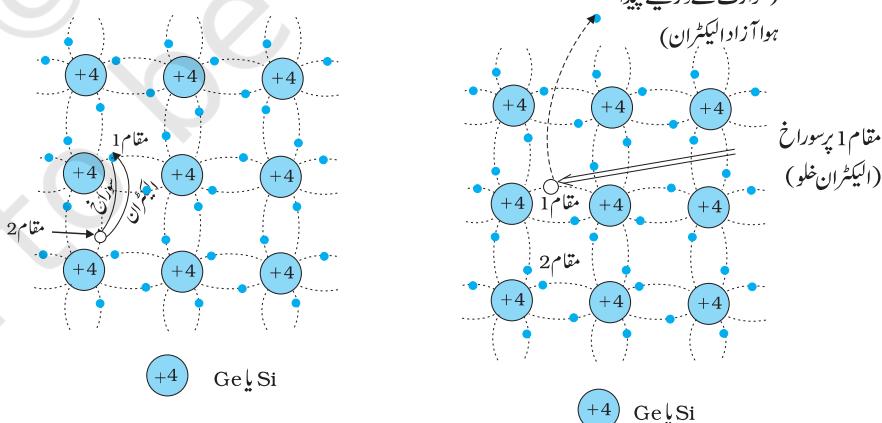


شکل 14.4: GeSi کی ساخت کا دو ابعادی اظہار، جس میں پچھلے درج حرارت پر شریک گرفت بند کھائے گئے ہیں (تمام بند برقرار ہیں)۔ علامت $\text{Si}+4$ کے اندر وہ قابلیوں کی نشان دہی کرتی ہے۔

پر کوڈ کر پہنچ سکتا ہے۔ اس طرح کی چھلاگ کے بعد اب مقام 2 پر ایک سوراخ ہے اور مقام 1 پر اب ایک الکٹران ہے۔ اس لیے، ظاہر، سوراخ مقام 1 سے حرکت کر کے مقام 2 پر پہنچ گیا ہے۔ نوٹ کریں کہ آغاز میں آزاد ہوا الکٹران [شکل (a)] سوراخ کی حرکت کے عمل میں شامل نہیں ہے۔ آزاد الکٹران، ایصال الکٹران کے بطور مکمل طور پر آزادانہ حرکت کرتا ہے اور ایک الکٹران کرنٹ I_e ایک لگائے گئے بر قی میدان کے تحت، پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب کرٹل میں کہیں بھی کوئی خالی بند ہو تو سوراخ کی حرکت صرف بند ہے ہوئے الکٹرانوں کی اصل حرکت کو بیان کرنے کا ایک سہل طریقہ ہے۔ ایک بر قی میدان کے زیرِ عمل یہ سوراخ منفی مضمون کی جانب حرکت کرتے ہیں اور سوراخ کرنٹ I_h دیتے ہیں۔ اس لیے کل کرنٹ I ، الکٹران کرنٹ I_e اور سوراخ کرنٹ I_h کا حاصل جمع ہے:

$$I = I_e + I_h \quad (14.2)$$

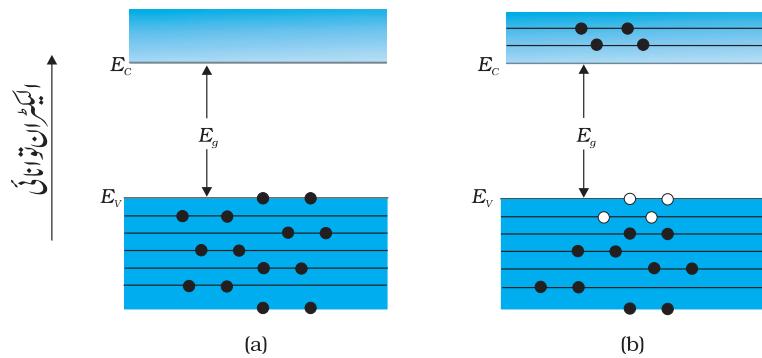
نوٹ کیا جاسکتا ہے کہ ایصال الکٹرانوں اور سوراخوں کے پیدا ہونے کے عمل کے علاوہ ایک ہم وقتی عمل ”باز ترکیب“ (Re-Combination) بھی ہوتا ہے جس میں الکٹران، سوراخ کے ساتھ دوبارہ مل جاتا ہے۔ حالت تو ازن میں، چارچ حاملوں کی پیدا ہونے کی شرح، باز ترکیب کی شرح کے مساوی ہوتی ہے۔ باز ترکیب، ایک الکٹران کے ایک سوراخ سے تصادم کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔



شکل 14.5(a): درمیانی درجات حرارت پر حرارتی توانائی کی وجہ سے مقام 1 پر سوراخ اور ایصال الکٹران بننے کا خاکہ ماذل (b) ایک سوراخ کی مکانہ حرارتی حرارت کا سادہ کیا ہوا اظہار۔ چلی با میں جانب کے شریک گرفت بند (مقام 2) سے الکٹران پچھلے سوراخ مقام 1 پر جاتا ہے، اور اپنے مقام پر ایک سوراخ چھوڑ دیتا ہے جو مقام 1 سے مقام 2 پر سوراخ کی ظاہرہ حرکت کی نشان دہی کرتا ہے۔

ایک ذاتی نیم موصل، $T=OK$ پر ایک حاجز کی طرح برتاؤ کرتا ہے، جیسا کہ شکل (a) 14.6 میں دکھایا گیا ہے۔ اعلا درجات حرارت پر ($T > OK$) حرارتی تو انائی ہی ہے جو کچھ الیکٹرانوں کو گرفت بینڈ سے ایصال بینڈ میں منتقل کرتی ہے۔ یہ حرارتی طور پر مشتعل الیکٹران، $OK < T <$ پر، ایصال بند کو جزوی طور پر بھرتے ہیں۔ اس لیے ایک ذاتی نیم موصل کی تو انائی بند ڈائیگرام شکل 14.6 (b) میں دکھائی گئی ڈائیگرام ہوگی۔ یہاں، ایصال

بینڈ میں کچھ الیکٹران دکھائے گئے ہیں۔ یہ گرفت بینڈ سے آئے ہیں اور وہاں مساوی تعداد میں سوراخ چھوڑ آئے ہیں۔



شکل (a) $T=OK$ پر ایک ذاتی نیم موصل، حاجز کی طرح برتاؤ کرتا ہے۔ (b) $T > OK$ پر، چار حرارتی طریقے سے بنے چار الیکٹران۔ بھرے ہوئے دائرے (●) الیکٹرانوں کی اور خالی دائرے (○) سوراخوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔

مثال 14.1: Ge, Si, C کی لیٹس ساخت کیسا ہے۔ پھر C حاجز کیوں ہے، جب کہ Ge اور Si ذاتی نیم موصل ہیں؟

حل: Ge اور Si کے 4 بندش الیکٹران، حسب ترتیب، دوسرے، تیسرا اور چوتھے مدار میں ہوتے ہیں۔ اس لیے ان ایمیوں سے ایک الیکٹران باہر نکانے کے لیے درکار تو انائی (یعنی کہ، آن کاری تو انائی E_g) کے لیے سب سے کم ہوگی، اس کے بعد Si کے لیے اور C کے لیے سب سے زیادہ ہوگی۔ اس لیے Ge اور Si میں ایصال کے لیے دستیاب آزاد الیکٹرانوں کی تعداد قابل لحاظ ہوتی ہے جب کہ C میں قابل نظر انداز حد تک خفیہ ہوتی ہے۔

مثال 14.1

14.4 بیرونی نیم موصل (EXTRINSIC SEMICONDUCTOR)

ایک ذاتی نیم موصل کی ایصالیت اس کے درجہ حرارت کے تابع ہوتی ہے، لیکن کم رہ درجہ حرارت پر اس کی ایصالیت بہت ادنی ہوتی ہے۔ اس لیے ان نیم موصلوں کو برایہ راست استعمال کر کے کوئی اہم الیکٹرانیک آلات نہیں تیار کیے جاسکتے۔ اس لیے ان کی ایصالیت میں اضافہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ ملاوٹوں (impurities) کو استعمال کر کے کیا جاسکتا ہے۔ جب ایک مناسب ملاوٹ کی بہت خفیہ مقدار، فرض کیجیے فی دس لاکھ میں چند حصے، ایک خالص نیم موصل میں ملائی جاتی ہے تو نیم موصل کی ایصالیت میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسے نیم موصلوں کو بیرونی نیم موصل یا ملاوٹ نیم موصل (lattice impurity semiconductor) کہتے ہیں۔ ایک پسندیدہ ملاوٹ کا جان بوجھ کر ملایا جانا ”ڈوپنگ“ (doping) (لفظی معنی: نشر ملانا) کہلاتا ہے اور ملاوٹ کے ایم ڈوپنگ کار (Dopants) کہلاتے ہیں۔ ایسی مادی شے کو ڈوپ شدہ نیم موصل

(Doped Semiconductor) بھی کہتے ہیں۔ ڈوپنگ کا روایا ہونا چاہیے کہ وہ بنیادی اصلی نیم موصل لیٹس کو بگاڑنے نہیں۔ یہ کریل میں بنیادی نیم موصل کے ایٹموں کے بہت ہی کم مقامات کو گھیرتا ہے۔ ایسی صورت حاصل کرنے کے لیے ایک لازمی شرط یہ ہے کہ ڈوپ کا راوی نیم موصل کے ایٹموں کے سائز تقریباً یکساں ہونے چاہئیں۔

چوگرفت (tetravalent) Ge یا Si میں ڈوپنگ کے لیے دو قسم کے ڈوپنگ کا استعمال کیے جاتے ہیں:

(i) پنج گرفت [P] (Pentavalent) (گرفت 5): جیسے آرسینک (As)،

انٹنی منی (Sb) فوسفورس (P) وغیرہ

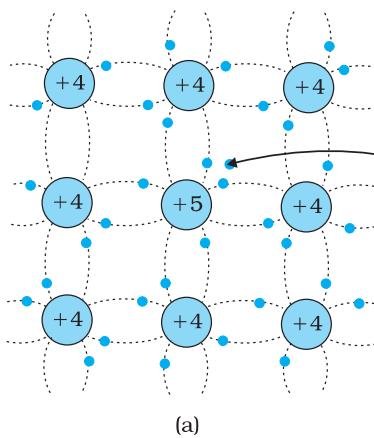
(ii) سه گرفت [In] (trivalent) (گرفت 3): جیسے انڈیم (In)، بورن (B)، المونیم (Al) وغیرہ

اب ہم اس سے بحث کریں گے کہ ڈوپنگ کس طرح نیم موصلوں میں چارج حاملوں کی تعداد (اور اس طرح ان کی ایصالیت) تبدیل کر دیتی ہے۔ Ge یا Si دوری جدول کے چوتھے گروپ سے تعقیل رکھتے ہیں، اس لیے ہم ڈوپنگ کا عضراں کے قریبی گروپ، پانچوں یا تیسرا گروپ، سے منتخب کرتے ہیں اور اس طرح اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ڈوپنگ کا رائیٹم کا سائز، یا Ge یا Si ایٹم کے سائز کے تقریباً یکساں ہو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ Ge یا Si میں پنج گرفتی اور سه گرفتی ڈوپنگ کا رشامل کرنے سے دو بالکل مختلف قسم کے نیم موصل حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ ذیل میں بحث کی گئی ہے۔

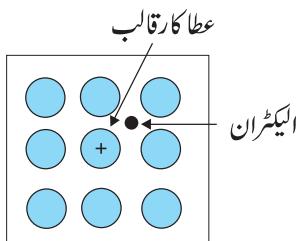
(i) n-type semiconductor - نیم موصل

فرض کیجیے ہم Ge یا Si کو ایک پنج گرفتی عضراں سے ڈوپ کرتے ہیں، جیسا کہ شکل 14.7 میں دکھایا گیا ہے۔ جب ایک 5+ گرفت والے عضراں کا ایٹم، Si کی کریل لیٹس میں ایک ایٹم کی جگہ گھیرتا ہے، تو اس کے الکٹرانوں میں سے چار ایکٹران تو چار سلی کون پڑو سیوں سے بند بناتے ہیں جب کہ پانچواں الکٹران اپنے موروثی ایٹم سے کمزور طور پر بندھا رہتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیوں کہ بند بنانے میں حصہ لینے والے چاروں الکٹرانوں کو یہ پانچواں الکٹران ایٹم کے موثر قابل کے بطور لیتا ہے۔ نتیجتاً اس الکٹران کو آزاد کرنے کے لیے درکار آئن کاری تو انائی بہت خفیف ہوتی ہے اور کمرہ درجہ حرارت پر بھی یہ الکٹران نیم موصل کی لیٹس میں حرکت کرنے کے لیے آزاد ہوتا ہے۔ مثلاً، جنمینیم کے لیے اس الکٹران کو اس کے ایٹم سے علاحدہ کرنے کے لیے درکار تو انائی 0.01 eV ہے اور سلی کون کے لیے 0.05 eV،

جب کہ اس کے مقابلے میں، منوع بینڈ کو عبور کرنے کے لیے درکار تو انائی جنمینیم کے لیے تقریباً 0.72 eV اور سلی



(a)



(b)

شکل (a): چوگرفتی Ge یا Si کے لیے ڈوپ کیا گیا پنج گرفتی عطا کار ایٹم (P, Sb, As) وغیرہ، جس سے n - قسم نیم موصل حاصل ہوتا ہے۔ اور (b): n - قسم مادی شے کا عام طور سے استعمال کیا جانے والا گاہک اظہار، جس میں صرف قائم مقام عطا کاروں کے غیر متحرک قابل ایک اضافی موثر ثابت چارج اور اس سے منسلک اضافی الکٹران کے ساتھ دکھائے گئے ہیں۔

ایسا اس لیے ہوتا ہے کیوں کہ بند بنانے میں حصہ لینے والے چاروں الکٹرانوں کو یہ پانچواں الکٹران ایٹم کے موثر قابل کے بطور لیتا ہے۔ نتیجتاً اس الکٹران کو آزاد کرنے کے لیے درکار آئن کاری تو انائی بہت خفیف ہوتی ہے اور کمرہ درجہ حرارت پر بھی یہ الکٹران نیم موصل کی لیٹس میں حرکت کرنے کے لیے آزاد ہوتا ہے۔ مثلاً، جنمینیم کے لیے اس الکٹران کو اس کے ایٹم سے علاحدہ کرنے کے لیے درکار تو انائی 0.01 eV ہے اور سلی کون کے لیے 0.05 eV،

کون کے لیے تقریباً 1.1 eV ، کمرہ درجہ حرارت پر، ذاتی نیم موصلوں میں کہیں زیادہ ہے۔ اس طرح، پنج گرفتی ڈوبنگ کار، ایصال کے لیے ایک اضافی الکٹران عطا کرتا ہے اور اس لیے اسے عطا کار ملاوٹ (donor impurity) کہتے ہیں۔ ڈوبنگ کار ایٹموں کے ذریعے ایصال کے لیے مہیا کیے گئے الکٹرانوں کی تعداد، ڈوبنگ سطح کے بہت زیادہ تابع ہے اور محصور درجہ حرارت میں ہونے والے کسی بھی اضافے کے غیر تابع ہے۔ دوسرا طرف، Si، ایٹموں سے پیدا ہوئے آزاد الکٹرانوں کی تعداد (سوراخوں کی مساوی تعداد کے ساتھ) میں درجہ حرارت کے ساتھ معمولی سماضافہ ہوتا ہے۔

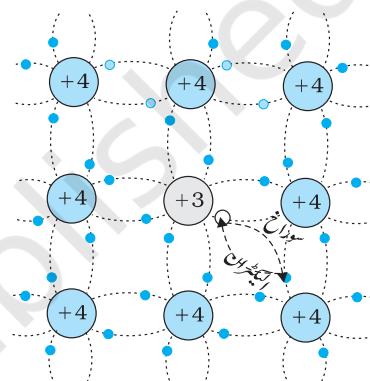
ایک ڈوبنگ شدہ نیم موصل میں ایصال الکٹرانوں کی کل تعداد n_e ، عطا کاروں کے ذریعے مہیا کیے گئے الکٹران اور ذاتی طور پر پیدا ہوئے الکٹرانوں پر مشتمل ہوتی ہے جب کہ سوراخوں کی تعداد n_h صرف ذاتی ماند (source) کی وجہ سے پیدا ہوئے سوراخوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ لیکن سوراخوں کے باز اتحاد کی شرح میں، الکٹرانوں کی تعداد میں اضافہ کی وجہ سے، اضافہ ہو جائے گا۔ نتیجتاً سوراخوں کی تعداد مزید کم ہو جائے گی۔

اس لیے، ڈوبنگ کی مناسب سطح کے ساتھ، ایصالی الکٹرانوں کی تعداد کو سوراخوں کی تعداد سے بہت زیادہ کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے ایک یہ ورنی نیم موصل میں، جسے پنج گرفتی ملاوٹ کے ساتھ ڈوب پکیا گیا ہو، الکٹران اکثریتی حامل ہو جاتے ہیں اور سوراخ اقلیتی حامل۔ اس لیے یہ نیم موصل، n - قسم نیم موصل کہلاتے ہیں۔

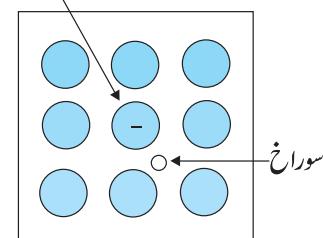
$$n_e \gg n_h \quad (14.3)$$

(ii) p - قسم نیم موصل (p-type semiconductor)

یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب Si یا Ge میں ایک سہ گرفتی ملاوٹ، جیسے Al، B، In، وغیرہ، کی ڈوبنگ کی جاتی ہے۔ ڈوبنگ کار میں Si یا Ge کے مقابلے میں ایک الکٹران کم ہے، اس لیے یہ ایٹم اپنے تین پڑو Si ایٹموں سے شریک گرفت بند بنا سکتا ہے لیکن چوتھے Si ایٹم کو پیش کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی الکٹران نہیں ہے۔ اس لیے چوتھے پڑو Si اور سہ گرفتی ایٹم کے درمیان بند میں ایک خلوی سوراخ ہوتا ہے، جیسا کہ شکل 14.8 میں دکھایا گیا ہے۔ کیوں لیس میں پڑو Si ایٹم کو سوراخ کی جگہ ایک الکٹران چاہیے ہوتا ہے، اس لیے ایٹم کے باہری مدار سے ایک الکٹران اس خلوکوپ کرنے کے لیے آسکتا ہے اور خود اپنے مقام پر ایک خلوی سوراخ چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے سوراخ، ایصال کے لیے دستیاب ہے۔ نوٹ کریں کہ سہ گرفتی یہ ورنی ایٹم، موثر طور پر منفی چارج شدہ ہو جاتا ہے جب وہ چوتھا الکٹران پڑو Si ایٹم سے بانٹتا ہے۔ اس لیے p - قسم مادی شے کے ڈوبنگ کار ایٹم کو ایک منفی چارج کا قالب معاد اس سے منسلک سوراخ، مانا جاسکتا ہے، جیسا کہ شکل (b) 14.8 میں دکھایا گیا ہے۔ یہ ظاہر ہی ہے کہ ایک قبول کار (acceptor) ایٹم ایک



قبول کار قالب



(b)

شکل (a) 14.8: چوکری Si یا Ge میں ڈوبنگ کیا گیا سہ گرفتی قبول کار ایٹم (In, Al, B) وغیرہ p - قسم نیم موصل فراہم کرتا ہے۔ (b) p - قسم مادی شے کا عام طور سے استعمال ہونے والا خاکہ اظہار، جس میں صرف قائم مقام قبول کار کا غیر متحرک قالب ایک موڑ اضافی منفی چارج اور اس سے منسلک سوراخ دکھائے گئے ہیں۔

سوراخ مہیا کرتا ہے۔ یہ سوراخ ان سوراخوں کے علاوہ ہیں جو ذاتی طور پر پیدا ہوتے ہیں، جب کہ ایصال الکٹرانوں کا مأخذ صرف ذاتی پیداوار ہے۔ اس لیے، اس طرح کی مادی شے کے لیے، سوراخ اکثریتی حامل ہیں اور الکٹران اقلیتی حامل ہیں۔ اس لیے سہ گرفتی ملاوٹ سے ڈوب کیے گئے بیرونی نیم موصل، p- قسم نیم موصل کھلاتے ہیں۔ p- قسم نیم موصلوں کے لیے، باز استفادہ کا عمل، ذاتی طور پر پیدا ہوئے الکٹرانوں کی تعداد n_e کو کم کر کے n_e کر دیتا ہے۔ p- قسم نیم موصلوں کے لیے

$$n_h \gg n_e \quad (14.4)$$

نوٹ کریں کہ کریل مجموعی چارج معادلیت برقرار رکھتا ہے کیوں کہ اضافی چارج حاملوں کا چارج لپیٹس میں آئن شدہ قالبوں کے چارج کے بالکل مساوی اور مختلف ہوتا ہے۔

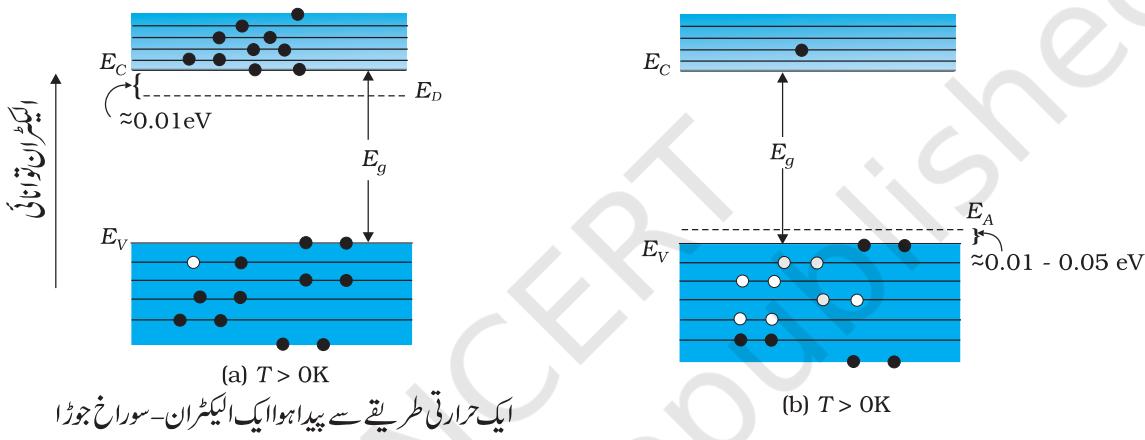
بیرونی نیم موصلوں میں، اکثریتی کرنٹ حاملوں کی زیادتی کی وجہ سے، ہری طریقے سے پیدا ہوئے اقلیتی چارج حاملوں کے لیے اکثریتی حاملوں سے مل سکنے کا اور اس طرح فنا ہو جانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے، ڈوبنگ کا رائیک قسم کے کرنٹ حاملوں کی ایک بڑی تعداد مہیا کر کے، جو اکثریتی حامل بن جاتے ہیں، بالواسطہ طور پر اقلیتی حاملوں کے ذاتی ارتکاز کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔

نیم موصل کی تو انائی بینڈ ساخت ڈوبنگ سے متاثر ہوتی ہے۔ بیرونی نیم موصلوں کی صورت میں، عطا کار ملاوٹوں اور قبول کار ملاوٹوں کی وجہ سے اضافی تو انائی حالتیں (باترتیب، E_A اور E_D) بھی پائی جاتی ہیں۔ n- قسم Si نیم موصل کی تو انائی بینڈ ڈائیگرام میں، عطا کار تو انائی منزل E_D ، ایصال بینڈ کی تلی (bottom)، E_D سے ذرا سایچے ہوتی ہے اور اس منزل سے الکٹران، خفیف تو انائی مہیا کیے جانے پر بھی، ایصال بینڈ میں چلے جاتے ہیں۔ کمرہ درجہ حرارت پر زیادہ تر عطا کار ایٹموں کی آئن سازی ہو جاتی ہے۔ Si کے بہت ہی کم ایٹموں ($\sim 10^{12}$) کی آین سازی ہوتی ہے۔ اس لیے ایصال بینڈ میں آنے والے زیادہ تر الکٹران عطا کار ملاوٹوں سے آتے ہیں، جیسا کہ شکل (a) 14.9 میں دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح، p- قسم نیم موصلوں کے لیے، قبول کار تو انائی منزل E_A ، گرفت بینڈ کی سب سے اوپری سطح E_V سے ذرا سا اوپر ہوتی ہے، جیسا کہ شکل (b) 14.9 میں دکھایا گیا ہے۔ تو انائی کی بہت خفیف مقدار فراہم کرنے پر گرفت بینڈ سے ایک الکٹران، منزل E_A پر پہنچ سکتا ہے اور قبول کار کی منفی آئن سازی کر سکتا ہے۔ (متداول طور پر، ہم یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ تو انائی کی بہت خفیف مقدار فراہم کرنے پر، منزل E_A سے سوراخ، نیچے ڈوب کر گرفت بینڈ میں آ جاتا ہے۔ باہری تو انائی حاصل کرنے پر الکٹران اور اٹھ جاتے ہیں اور سوراخ نیچے گرجاتے ہیں) کمرہ درجہ حرارت پر زیادہ تر قبول کار ایٹموں کی آئن سازی ہو جاتی ہے اور اس طرح گرفت بینڈ میں سوراخ رہ جاتے ہیں۔ اس لیے، کمرہ درجہ حرارت پر، گرفت بینڈ میں سوراخوں کی کثافت، زیادہ تر بیرونی نیم موصل میں ملاوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک نیم موصل میں، حرارتی تو ازن کی حالت میں، الکٹران اور سوراخ کے ارتکازدیے جاتے ہیں۔

$$n_e n_h = n_i^2$$

14.5

حالاں کے مندرجہ بالا بیان بڑی حد تک تقریبی ہے اور مفروضوں پر مبنی ہے، پھر بھی اس سے دھاتوں، حاصلوں اور نیم موصلوں (بیرونی اور ذاتی) کے درمیان فرق کو سادہ طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ C، Si، Ge کی مزاحمت (resistivity) میں فرق ان کے ایصال بینڈ اور گرفت بینڈ کے درمیان توانائی فصل پر مختصر ہے۔ C (بیر)، Si اور Ge کے لیے یہ توانائی فصل، بالترتیب، ہیں: 0.7 eV، 1.1 eV، 5.4 eV اور Sn، IV گروپ عنصر ہے لیکن یہ ایک دھات ہے، کیوں کہ اس میں توانائی فصل O eV ہے۔



شکل 14.9: توانائی بینڈ (a) $T > 0\text{K}$ پر قسم نیم موصل کے (b) $T > 0\text{K}$ پر قسم نیم موصل کے

مثال 14.2: فرض کیجیے ایک خالص Si کریل میں $15 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$ گرفتی As ppm کے ارتکاز سے ڈوپ کیا گیا ہے۔ الیکٹرانوں اور سوراخوں کی تعداد کا حساب لگائیے۔

$$n_i = 1.5 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$$

حل: نوٹ کریں کہ حرارتی طریقے پر پیدا ہوئے الیکٹرانوں کی تعداد ($n_i \sim 10^{16} \text{ m}^{-3}$)، ڈوپنگ کے ذریعے پیدا ہوئے الیکٹرانوں کی تعداد کے مقابلے میں قابل نظر انداز حد تک خفیف ہے۔ اس لیے:

$$n_e \approx N_D$$

کیوں کہ، سوراخوں کی تعداد

$$n_h = \frac{(2.25 \times 10^{32})}{(5 \times 10^{22})}$$

$$\sim 4.5 \times 10^9 \text{ m}^{-3}$$

مثال 14.2

14.5 پی-این جنکشن (p-n JUNCTION)

ایک p-n جنکشن کئی نیم موصل آلات، جیسے ڈائوڈ، ٹرانسیستروں وغیرہ، کا بنیادی جز ترکیبی ہے۔ جنکشن کے برتوں کا واضح فہم دیگر نیم موصل آلات کی کارکردگی کا تجزیہ کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک جنکشن کیسے تشکیل پاتا ہے اور باہری اطلاقی دولٹج [جسے میلان (Bias) بھی کہتے ہیں] کے زیراث ایک جنکشن کیسے برتوں کرتا ہے۔

14.5.1 پی-این جنکشن کی تشکیل (p-n Junction formation)

ایک پتلا p- قسم سلی کون (p-Si) نیم موصل ورق (ویفر wafer) لجئے۔ پنج گرفتی ملاوٹ کی ایک نہایت درست خفیف مقدار شامل کر کے، Si-p ویفر کے ایک جز کو Si-n میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ ایسے کئی طریقے ہیں جن کے ذریعے ایک نیم موصل تشکیل دیا جاسکتا ہے۔ ویفر میں اب ایک p-n علاقہ ہے اور ایک p-n علاقوں کے درمیان ایک فلزکاری (metallurgical) جنکشن ہے۔

ایک p-n جنکشن کی تشکیل کے دوران دو اہم عمل ہوتے ہیں: نفوذ (Diffusion) اور باد آور دگی (Drift)۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک n- قسم نیم موصل میں، الیکٹرانوں کا ارتکاز (الیکٹرانوں کی تعداد فی اکائی جم) سوراخوں کے ارتکاز سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک p- قسم نیم موصل میں سوراخوں کا ارتکاز الیکٹرانوں کے ارتکاز سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک p-n جنکشن کی تشکیل کے دوران، -p اور -n اطراف میں ارتکاز ڈھلان کی وجہ سے، سوراخ p- جانب سے n- جانب (→n) نفوذ کرتے ہیں اور الیکٹران n- جانب سے p- جانب نفوذ کرتے ہیں (n-p)۔ چارچ حاملوں کی اس حرکت کی وجہ سے جنکشن کے سروں کے درمیان ایک نفوذ کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔

جب ایک الیکٹران $p \rightarrow n$ نفوذ کرتا ہے تو یہ n- جانب ایک آئن شدہ عطا کار چھوڑ آتا ہے۔ یہ آئن شدہ عطا کار (ثبت چارچ) غیر متحرک ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہ اپنے ارگرد کے ایمیوں سے بندھا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے الیکٹران $P \rightarrow n$ نفوذ کرنا جاری رکھتے ہیں، ثبت چارچ کی ایک تہہ، (ثبت چارچ - فضاعلاقہ) جنکشن کی n- جانب بنتی جاتی ہے۔

اسی طرح جب $n \rightarrow p$ ایک سوراخ نفوذ کرتا ہے، جس کی وجہ ارتکاز ڈھلان ہے، تو یہ اپنے پیچھے ایک آئن شدہ قبول کار (منفی چارچ) چھوڑ آتا ہے جو کہ غیر متحرک ہوتا ہے۔ جیسے جیسے سوراخ نفوذ جاری رکھتے ہیں، منفی چارچ کی ایک تہہ (یا منفی چارچ - فضاعلاقہ) جنکشن کی p- جانب بنتی جاتی ہے۔ یہ فضا - چارچ علاقہ، جو جنکشن کے دونوں جانب ہوتا ہے، مل کر عسرت علاقہ (Depletion region) کہلاتا ہے کیوں کہ جنکشن کے سروں کے درمیان آغازی حرکت میں حصہ لینے والے الیکٹران اور سوراخ اس علاقے کو اس کے آزاد چارجوں سے خالی کر دیتے ہیں (شکل 4.10)۔ عسرت علاقہ کی موٹائی ایک مائیکرومیٹر کے دسویں حصے کے درجے کی ہوتی ہے۔ جنکشن کی n- جانب ثبت فضا - چارچ علاقہ کی وجہ سے اور جنکشن کی p- جانب منفی فضا - چارچ علاقے کی وجہ سے ایک برقی میدان پیدا ہوتا



ہے جس کی سمت ثابت چارج سے منفی چارج کی جانب ہوتی ہے۔ اس میدان کی وجہ سے جنکشن کی p-جانب کا الیکٹران n-جانب حرکت کرتا ہے اور جنکشن کی n-p-جانب کا ایک سوراخ (drift) کھلاتی ہے۔ بر قی میدان کی وجہ سے چارج حاملوں کی حرکت باداً وردگی ہے، بہنا شروع ہو جاتا ہے (شکل 14.10)۔

شروعات میں، نفوذ کرنٹ زیادہ ہوتا ہے اور باداً وردگی کرنٹ کم ہوتا ہے۔ جیسے جیسے نفوذ کا

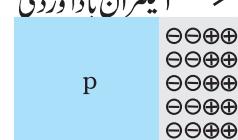
عمل جاری رہتا ہے، فضا۔ چارج علاقے جنکشن کے دونوں جانب، وسیع ہوتے جاتے ہیں، جس سے بر قی میدان کی طاقت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور اس لیے باداً وردگی کرنٹ بڑھتا جاتا ہے۔ یہ عمل جاری رہتا ہے تک کہ باداً وردگی کرنٹ، نفوذ کرنٹ کے مساوی ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک p-n جنکشن تشکیل پاتا ہے۔ ایک p-n جنکشن میں، حالت توازن میں کوئی کرنٹ نہیں ہوتا۔

n- علاقے سے الیکٹرانوں کا زیال اور p- علاقے میں الیکٹرانوں کے حصول کی وجہ سے دونوں علاقوں کے جنکشن کے سروں کے درمیان ایک مضمر فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس مضمر کی قطبیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ حاملوں کے مزید بہاؤ کی مخالفت کرتی ہے تاکہ ایک توازن کی حالت رہ سکے۔ شکل 14.11 میں حالت توازن میں p-n جنکشن اور جنکشن کے سروں کے درمیان مضمر دکھایا گیا ہے۔ n- مادی شے کی الیکٹران ضائع کیے ہیں جب کہ p- مادی شے نے الیکٹران حاصل کیے ہیں۔ اس لیے p- مادی شے کی مناسبت سے n- مادی شے ثابت ہے۔ کیوں کہ یہ مضمر n- علاقے سے p- علاقے میں الیکٹرانوں کی حرکت روکنے کی کوشش کرتا ہے، اسے اکثر روک مضمر (Barrier Potential) کہتے ہیں۔

مثال 14.3: کیا ہم p-n یہم موصل کی ایک سل کو جنکشن حاصل کر سکتے ہیں؟

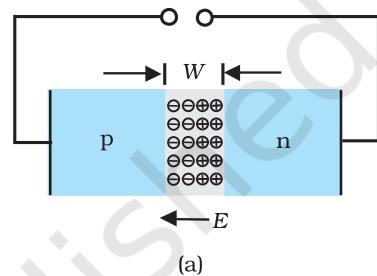
حل: نہیں! کوئی بھی سل (slab) چاہے وہ کتنی چھپی (flat) بھی کیوں نہ ہو، اس میں کریسل کے ایٹمیں کی درمیانی خالی جگہ ($\sim 3 \text{ \AA}$) سے زیادہ کھر دراپن ہو گا اور اس لیے ایٹمی سطح پر مستقل تماس ممکن نہیں ہے۔ بہرہے چارج حاملوں کے لیے جنکشن ایک عدم تسلسل (Discontinuity) کے بطور بر تاؤ کرے گا۔

الیکٹران نفوذ



عسرت علاقہ سو راخ باداً وردگی

شکل 14.10: p-n جنکشن تشکیل پانے کا عمل

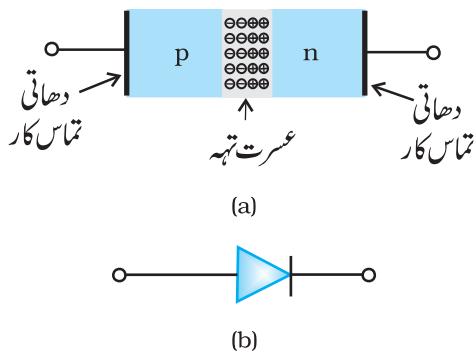


شکل 14.11: (a) حالت توازن میں (v=0) ایک ڈائیوڈ (b) بغیر کسی میلان کے تحت روک مضمر

مثال 14.3

14.6 یہم موصل ڈائیوڈ (SEMICONDUCTOR DIODE)

ایک یہم موصل ڈائیوڈ [شکل (a)] 14.12] نیادی طور پر ایک p-n جنکشن ہے جس کے سروں پر بیرونی ولٹیج کا اطلاق کرنے کے لیے دھاتی تماس کارگے ہوتے ہیں۔ یہ ایک دو۔ ٹرینل آلمہ ہے۔ ایک p-n جنکشن کو عالمی طور پر ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے شکل (b) 14.12 میں دکھایا گیا ہے۔



شکل 14.12: (a) نیم موصل ڈائیوڈ (b) p-n جتناشن ڈائیوڈ کی علامت

تیر کے نشانوں کی سمت کرنٹ کی قرارداد کے مطابق دی جانے والی (conventional) سمت کو ظاہر کرتی ہیں (جب کہ ڈائیوڈ پیش مائل ہے)۔ حالت توازن مضمکوڈ ڈائیوڈ کے سروں کے درمیان ایک بیرونی ولٹیج V کا اطلاق کر کے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ جتناشن ڈائیوڈ کی توازن حالت (بغیر میلان کے) (شکل (a) 14.11 اور شکل (b) میں دکھائی گئی ہے)۔

14.6.1 پیش مائل پی۔ این جتناشن ڈائیوڈ

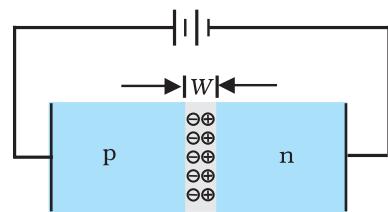
(p-n junction diode under forward bias)

جب ایک نیم موصل ڈائیوڈ کے سروں کے درمیان ایک بیرونی ولٹیج V کا اطلاق اس طور پر کیا جاتا ہے کہ p- علاقہ کو بیڑی کے ثابت ٹریمنل سے نسلک کیا جاتا ہے اور n- جانب کو منفی ٹریمنل سے (شکل (a) 14.13) تو یہ پیش مائل کہلاتا ہے۔ اطلاقی ولٹیج کا زیادہ تر حصہ عسرتی علاقے کے سروں کے درمیان ہوتا ہے اور جتناشن کے p- جانب اور n- جانب کے سروں کے درمیان یہ ولٹیج قابل نظر انداز ہوتی ہے۔ (ایسا س لیے ہوتا ہے کیوں کہ عسرت علاقے۔ ایسا علاقہ جس میں کوئی چارج نہیں ہیں۔ کی مزاحمت، n- جانب اور p- جانب کی مزاحمت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے) اطلاقی ولٹیج کی سمت، اندر قائم ہوئے مضمک V_0 کی سمت کے مخالف ہوتی ہے۔ نتیجتاً، عسرت علاقہ کی چوڑائی کم ہو جاتی ہے اور رکاوٹ کی اونچائی بھی کم ہو جاتی ہے [شکل (b) 14.13]۔ پیش میلان کے تحت موثر رکاوٹ اونچائی $(V_0 - V)$ ہے۔

اگر لگائی گئی ولٹیج کی قدر خفیف ہے، تو رکاوٹ مضمک بھی توازن قدر سے تھوڑا سا کم ہو گا اور مادی شے میں حاملوں کی صرف ایک خفیف تعداد۔ وہ حامل جو سب سے اوپری توانائی منزلاوں میں ہوں گے۔ کی، ہی توانائی ہو گی کہ وہ جتناشن کو عبور کر سکیں۔ اس لیے کرنٹ کی قدر بھی خفیف ہو گی۔ اگر ہم لگائی گئی ولٹیج کی قدر میں قابل لحاظ اضافہ کر دیں تو رکاوٹ اونچائی کم ہو جائے گی اور زیادہ حاملوں کی توانائی درکار توانائی سے زیادہ ہو جائیگی۔ اس لیے کرنٹ میں اضافہ ہو جائے گا۔ لگائی گئی ولٹیج کی وجہ سے، n- جانب سے الیکٹران، عسرت۔ علاقہ کو عبور کر لیتے ہیں اور p- جانب پہنچ جاتے ہیں (جہاں وہ اقلیتی حامل ہیں)۔ اسی طرح p- جانب سے سوراخ، جتناشن کو پار کر لیتے ہیں اور n- جانب پہنچ جاتے ہیں (جہاں وہ اقلیتی حامل ہیں)۔ پیش میلان کے تحت ہونے والا یعنی اقلیتی حامل داخل (minority carrier injection) کہلاتا ہے۔ جتناشن حد پر (دونوں طرف)، اقلیتی حاملوں کا ارتکاز، جتناشن سے زیادہ فاصلوں کے مقامات پر ان کے ارتکاز کے مقابلے سے قابل لحاظ حد تک بڑھ جاتا ہے۔

اس ارتکاز ڈھلان کی وجہ سے، p- جانب داخل کیے گئے الیکٹرانوں کا، p- جانب کے جتناشن کنارے سے

p-جانب کے دوسرے سرے میں، نفوذ ہو جاتا ہے (شکل 14.14)۔ دونوں جانب چارج حاملوں کی اس حرکت سے کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ کل ڈائیوڈ پیش کرنٹ، سوراخ نفوذ کرنٹ اور الکٹرون نفوذ کی وجہ سے پیدا ہونے والے، قرارداد کے مطابق، کرنٹ کا حامل جمع ہوتا ہے۔ اس کرنٹ کی عددی قدر mA کے درجہ کی ہوتی ہے۔

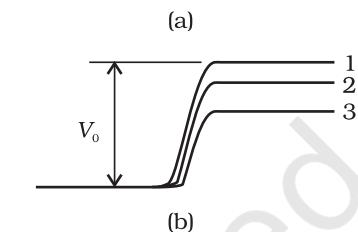


14.6.2 پس مائل ڈائیوڈ - این جنکشن ڈائیوڈ

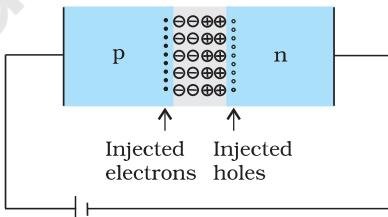
(p-n junction diode under reverse bias)

جب ایک بیروفی ولٹیج V کا اطلاق اس طرح کیا جاتا ہے کہ ڈائیوڈ کی n-جانب ثابت ہوا اور p-جانب منفی ہوتا ہے پس مائل کھلاتا ہے [شکل 14.15(a)]۔ لگائی گئی ولٹیج کا زیادہ تر حصہ عرست علاقے کے سروں کے درمیان ہوتا ہے۔ لگائی گئی ولٹیج کی سمت بھی وہی ہوتی ہے جو رکاوٹ مضمر کی سمت ہے۔ نیتھر رکاوٹ اونچائی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور عرست علاقہ، بر قی میدان میں تبدیلی کی وجہ سے، مزید چوڑا ہو جاتا ہے۔ پس میلان کے تحت موثر رکاوٹ اونچائی ($V_0 + V$) ہے [شکل 14.15(b)]۔ اس لیے، نفوذ کرنٹ، پیش میلان کے تحت ڈائیوڈ کے مقابلے میں بہت کم ہو جاتا ہے۔

جنکشن کے بر قی میدان کی سمت اس طرح ہوتی ہے کہ اگر p-جانب پر الکٹران یا n-جانب پر سوراخ، اپنی بے ترتیب حرکت کے دوران جنکشن کے قریب آئیں تو وہ اس کے اکثریتی علاقے میں دھکیل دیے جائیں۔ حاملوں کی یہ بادا اور دگی کرنٹ پیدا کرتی ہے۔ بادا اور دگی کرنٹ چند mA کے درجہ کا ہوتا ہے۔ یہ بہت قلیل ہے کیونکہ یہ حاملوں کی ان کی اقلیتی۔ جانب سے اکثریتی۔ جانب کی طرف جنکشن کے سروں کے درمیان حرکت کی وجہ سے ہے۔ پیش میلان کے تحت بھی بادا اور دگی کرنٹ ہوتا ہے، لیکن یہ مقابلہ نظر انداز ہوتا ہے (A)۔ اگر اس کا مقابلہ داخل کیے گئے حاملوں کی وجہ سے پیدا ہوئے کرنٹ سے کیا جائے جو عموماً mA میں ہوتا ہے۔



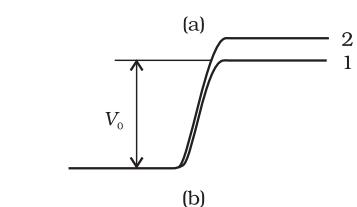
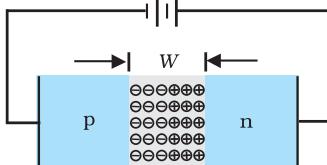
شکل 14.13: (a) پیش میلان کے تحت جنکشن (b) رکاوٹ مضمر (i) بیڑی کے بغیر (ii) قلیل بیڑی و ولٹیج (iii) اعلا بیڑی و ولٹیج
داخل کیے گئے سوراخ داخل کیے گئے الکٹران



شکل 14.4: پیش میلان اقلیتی داخل داخل

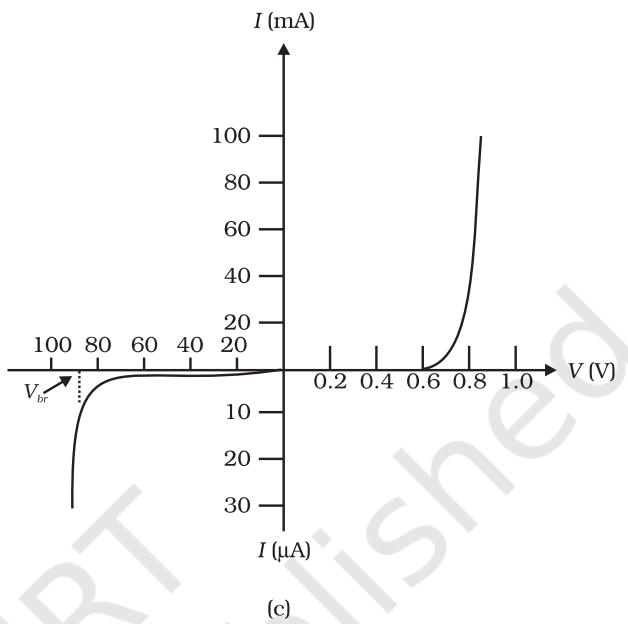
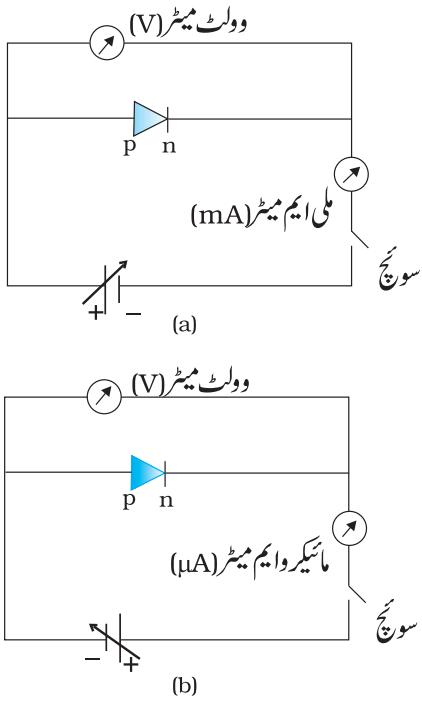
ڈائیوڈ پس کرنٹ، لگائی گئی ولٹیج کے بہت زیادہ تابع نہیں ہوتا۔ بہت قلیل ولٹیج بھی اقلیتی حاملوں کو جنکشن کی ایک جانب سے جنکشن کی دوسری جانب دھکیلنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ کرنٹ، لگائی گئی ولٹیج کی عددی قدر سے حدود نہیں ہوتا بلکہ جنکشن کے دونوں جانب اقلیتی حاملوں کے ارتکاز سے محدود ہوتا ہے۔

پس میلان کے تحت کرنٹ بنا دی طور پر، ایک فاصل پس میلان ولٹیج تک، ولٹیج کے غیر تابع ہوتا ہے، جو تخطی ولٹیج (Breakdown Voltage) V_{br} کہلاتی ہے۔ جب $V = V_{br}$ تو ڈائیوڈ پس کرنٹ بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ میلان ولٹیج میں ذرا سا اضافہ بھی کرنٹ میں بڑی تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اگر پس کرنٹ کی قدر کو شارشدہ قدر (Rated Value) (بنانے والے کے ذریعے متعین کی گئی) سے نیچے ایک بیروفی سرکٹ کے ذریعے محدود نہ کھا جائے تو n-p جنکشن خراب ہو جائے گا۔ جب یہ اپنی شارشدہ قدر سے زیادہ ہو جاتا ہے تو زیادہ گرم ہو جانے کی وجہ سے ڈائیوڈ خراب ہو جاتا ہے۔ ایسا پیش میلان کے تحت بھی ہو سکتا ہے اگر پیش کرنٹ اپنی شارشدہ قدر سے زیادہ ہو جائے۔



شکل 14.15: (a) پس میلان کے تحت جنکشن ڈائیوڈ (b) پس میلان کے تحت رکاوٹ مضمر

نیم موصل الکٹرونیات: ماڈے، آلات اور سادہ سرکٹ



شکل 14.16: ایک p-n ڈائوڈ کے مخصوص خم کا مطالعہ کرنے کے تجرباتی سرکٹ کی ترتیب
(a) پیش میلان میں (b) پس میلان میں (c) ایک سلی کون ڈائوڈ کا خاص مخصوص خم

ایک ڈائوڈ کے $I-V$ مخصوص خم (یعنی کہ، کرنٹ کی تبدیلی بطور تفاضل اطلاقی ولٹیج) کا مطالعہ کرنے کے لیے سرکٹ ترتیب شکل (a) اور (b) 14.16 میں دکھائی گئی ہے۔ بیڑی کو ڈائوڈ سے ایک پوٹینشیو میٹر (یا رہیوٹیٹ) کے ذریعے منسلک کیا گیا ہے تاکہ ڈائوڈ پر لگائی گئی ولٹیج کو تبدیل کیا جاسکے۔ ولٹیج کی مختلف قدروں کے لیے، کرنٹ کی تدریں نوٹ کی جاتی ہیں۔ اور اس کے درمیان ایک گراف حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ شکل (c) 14.16 میں دکھایا گیا ہے۔ نوٹ کریں کہ پیش میلان پیائش میں، ہم ایک ملی ایم میٹر استعمال کرتے ہیں کیوں کہ کرنٹ کی متوقع قدر زیادہ ہوتی ہے (جیسا کہ پچھلے حصے میں وضاحت کی جا چکی ہے)، جب کہ پس میلان میں کرنٹ کی پیائش کے لیے ایک مائکرو میٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ شکل (c) 14.6 میں دیکھ سکتے ہیں کہ پیش میلان میں کرنٹ پہلے بہت آہستہ بڑھتا ہے، تقریباً قابل نظر انداز حد تک، جب تک کہ ڈائوڈ کے سروں کے درمیان لگائی گئی ولٹیج ایک مخصوص قدر سے زیادہ نہیں ہو جاتی۔ اس مخصوص ولٹیج کے بعد، ڈائوڈ کرنٹ میں قابل لحاظ اضافہ (وقت نمائی طور پر) ہوتا ہے، چاہے ڈائوڈ میلان ولٹیج میں بہت خفیف اضافہ بھی کیا جائے۔ اس ولٹیج کو ڈیزیر ولٹیج یا قاطع ولٹیج بھی کہتے ہیں۔ ($0.2V$ ~ جنمیں ڈائوڈ کے لیے اور $0.7V$ ~ سلی کون ڈائوڈ کے لیے)۔

جب ڈائوڈ پس میلان میں ہوتا ہے تو کرنٹ بہت خفیف ہوتا ہے (μA) اور میلان میں تبدیلی کے ساتھ تقریباً مستقلہ رہتا ہے۔ اسے پس سیر شدگی کرنٹ (reverse saturation current) کہتے ہیں۔ لیکن، کچھ خاص

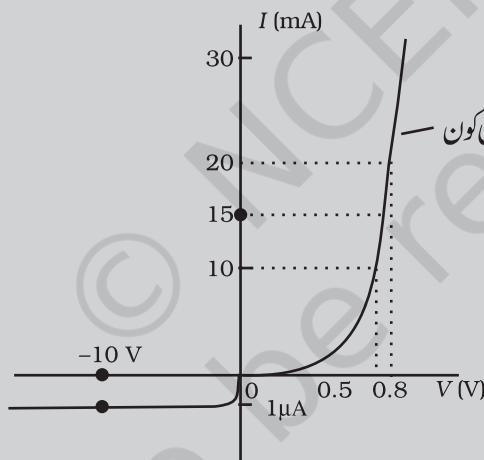
صورتوں میں، بہت زیادہ پس میلان پر (تعطیلی ولٹیج)، کرنٹ میں اچانک اضافہ ہوتا ہے۔ ڈائیوڈ کے اس خاص عمل سے آگے حصہ 14.8 میں بحث کی گئی ہے۔ عام مقاصد کے لیے استعمال کیے جانے والے ڈائیوڈ، پس سیر شدگی کرنٹ علاقے سے باہر نہیں استعمال کیے جاتے۔

مندرجہ بالا بحث سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ p-n جگنشن ڈائیوڈ، بنیادی طور پر، ایک ہی سمت میں کرنٹ کا بہاؤ ہونے دیتا ہے (پیش میلان)۔ پس میلان مزاحمت کے مقابلے میں پیش میلان مزاحمت کی قدر کم ہوتی ہے۔ یہ خاصیت ac ولٹیجوں کی سمت کاری (Rectification) میں استعمال کی جاتی ہے، جیسا کہ اگلے حصے میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم ڈائیوڈ کے لیے ایک مقدار، جو حرکی مزاحمت کھلائی ہے، کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ولٹیج میں خفیف تبدیلی ΔV کی کرنٹ میں خفیف تبدیلی ΔI سے نسبت ہے:

$$r_d = \frac{\Delta V}{\Delta I} \quad (14.6)$$

مثال 14.4: ایک سلی کون ڈائیوڈ کا $V_D = -10 \text{ V}$ مخصوص نام شکل 14.17 میں دکھایا گیا ہے۔ ڈائیوڈ کی مزاحمت

تحسیب کیجیے: (a) $I_D = 15 \text{ mA}$ پر V_D پر (b) $I_D = 15 \text{ mA}$ پر V_D



شکل 14.17

حل: ڈائیوڈ مخصوص نام کو $I = 10 \text{ mA}$ سے $I = 20 \text{ mA}$ کے درمیان، مبدے سے گذرتا ہوا ایک مستقیم خط مانتے ہوئے، ہم اوم کا قانون استعمال کر کے مزاحمت تحسیب کر سکتے ہیں:

(a) $I = 20 \text{ mA}$, $V = 0.8 \text{ V}$; $I = 10 \text{ mA}$, $V = 0.7 \text{ V}$:

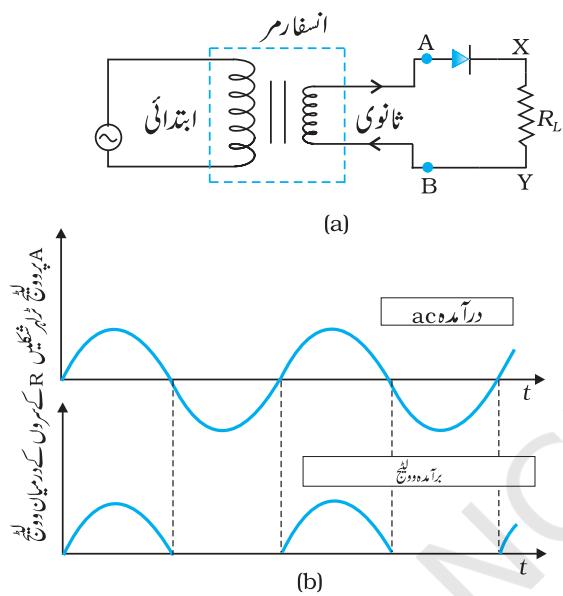
$$r_{fb} = \frac{\Delta V}{\Delta I} = \frac{0.1 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = 10 \Omega$$

(b) اس لیے $I = 1 \mu\text{A}$ پر $V = -10 \text{ V}$ ، منحنی سے مانیں

$$r_{rb} = \frac{10 \text{ V}}{1 \mu\text{A}} = 1.0 \times 10^7 \Omega$$

14.7 جنکشن ڈائیوڈ کا بطور سمت کار استعمال (APPLICATION OF JUNCTION DIODE AS A RECTIFIER)

جنکشن ڈائیوڈ کے $-V$ مخصوص خم سے ہم دیکھتے ہیں کہ کرنٹ کو صرف اسی وقت گزرنے دیتا ہے جب یہ پیش مائل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ایک جنکشن ڈائیوڈ کے سروں کے درمیان تبادل و ولٹیج لگائی جائے تو کرنٹ سائیکل کے صرف اس حصے میں ہوتا ہے جب ڈائیوڈ پیش مائل ہوتا ہے۔ اس خاصیت کا استعمال تبادل و ولٹیج کی سمت کاری کے لیے کیا جاتا ہے اور اس مقصد کے لیے استعمال کیا جانے والا سرکٹ سمت کار کہلاتا ہے۔



شکل 14.18: (a): نصف-لہر سمت کار سرکٹ (b): سمت کار سرکٹ سے درآمدہ ac وولٹیج اور برآمدہ ac وولٹیج کی

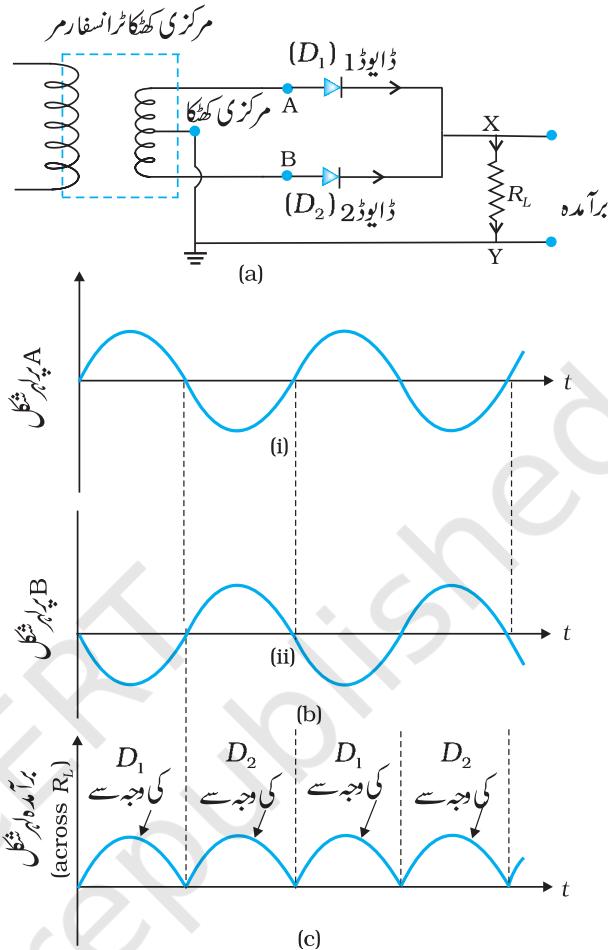
اگر ڈائیوڈ کے سروں کے درمیان، جو ایک لوڈ کے ساتھ سلسلہ وار طرز میں جڑا ہو، ایک تبادل و ولٹیج لگائے تو ac درآمدہ کے صرف نصف سائیکلوں کے دوران ہی لوڈ کے سروں کے درمیان ایک ایک پلس وولٹیج ظاہر ہوگی۔ ایسا اس دوران ہو گا جب ڈائیوڈ پیش مائل ہوگا۔ ایسا سمت کار سرکٹ، جو کہ شکل 14.18 میں دکھایا گیا ہے، نصف-لہر سمت کار کہلاتا ہے۔ ایک ٹرانسفارمر کا ثانوی کوائل، A، اور ٹرمیلوں کے درمیان مطلوبہ ac وولٹیج مہیا کرتا ہے۔ جب A پر ولٹیج ثابت ہوتی ہے تو ڈائیوڈ پیش مائل ہوتا ہے اور ایصال کرتا ہے۔ جب A مخفی ہوتا ہے تو ڈائیوڈ پس مائل ہوتا ہے اور ایصال نہیں کرتا۔ ڈائیوڈ کا پس سیرشدگی کرنٹ ناقابل لحاظ ہوتا ہے اور اسے تمام عملی صورتوں میں صفر مانا جاسکتا ہے۔ (ایک ڈائیوڈ کی پس قطع ولٹیج کو ٹرانسفارمر کے سینٹری کوائل پر ac وولٹیج کی فراز قدر سے کافی زیادہ ہونا چاہیے تاکہ ڈائیوڈ پس قطع سے محفوظ رہ سکے۔

اس لیے، ac کے ثبت نصف سائیکل میں، لوڈ مزاحمہ R_L میں سے کرنٹ گزرتا ہے اور ہمیں ایک برآمدہ ولٹیج ملتی ہے، جیسا کہ شکل (b) 14.18 میں دکھایا گیا ہے، جب کہ مخفی نصف سائیکل میں کوئی کرنٹ نہیں گزرتا۔ اگلے ثبت نصف سائیکل میں ہمیں برآمدہ ولٹیج دوبارہ ملتی ہے۔ اس لیے، حالاں کہ برآمدہ ولٹیج اب بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے لیکن ایک سمت میں ہی محدود رہتی ہے اور ستمی (rectified) کہلاتی ہے۔ کیوں کہ اس کرنٹ کا سمتی برآمدہ، درآمدہ ac لہر کے صرف نصف حصے کے لیے حاصل ہوتا ہے، یہ نصف-لہر سمت کار کہلاتا ہے۔

وہ سرکٹ جس میں دو ڈائیوڈ استعمال کیے جاتے ہیں، جسے شکل (a) 14.19 میں دکھایا گیا ہے، ac سائیکل کے ثبت نصف اور مخفی نصف، دونوں، کے لیے برآمدہ سمتی ولٹیج دیتا ہے۔ اس لیے اسے مکمل-لہر نصف کار کہتے ہیں۔ یہاں دونوں ڈائیوڈ کی p-جانب کو ٹرانس ارمر کے سینٹری کے سروں سے منسلک کیا جاتا ہے۔ دونوں ڈائیوڈ کی n-جانب آپس میں جوڑ دی جاتی ہیں اور برآمدہ دوں ڈائیوڈ کے اس مشترک نقطے اور ٹرانسفارمر کے سینٹری کوائل کے وسطی نقطے کے درمیان

لیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک مکمل۔ لہر سمت کار کے لیے، ٹرانسفارمر کے سینڈری کوائل میں ایک مرکزی کھکھا (Centre tapping) (a) میں کیا جاتا ہے اور اس لیے اسے مرکزی کھکھا ٹرانسفارمر کہتے ہیں۔ جیسا کہ شکل (c) 14.19 سے دیکھا جاسکتا ہے، ہر ڈائیوڈ سے سمتی ہوئی دو لیٹچ کل سینڈری دو لیٹچ کا نصف ہوتی ہے۔ ہر ڈائیوڈ صرف نصف سائیکل کے لیے ہی سمت کاری کرتا ہے، لیکن دونوں ایسا تبادل سائیکلوں کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے، ان کے مشترک کہ ٹرینیل اور ٹرانسفارمر کے مرکزی کھکھے کے درمیان برآمدہ ایک مکمل۔ لہر سمت کار برآمدہ بن جاتا ہے۔ [نوٹ کریں کہ مکمل لہر سمت کار کا ایک اور سرکٹ بھی ہے، جس میں مرکزی کھکھا ٹرانسفارمر استعمال نہیں ہوتا بلکہ چار ڈائیوڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔] فرض کیا کہ A پر درآمدہ دو لیٹچ کسی بھی لمحہ وقت پر، مرکزی کھکھے کی مناسبت سے ثابت ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس وقت B پر دو لیٹچ، فیز سے باہر ہونے کی وجہ سے، منفی ہو گی، جیسا کہ شکل (b) 14.19 میں دکھایا گیا ہے۔ اس لیے ڈائیوڈ D_1 پیش مائل ہو جاتا ہے اور ایصال کرتا ہے۔ (جب کہ ڈائیوڈ D_2 پس مائل ہونے کی وجہ سے ایصال نہیں ہوتا)۔ اس لیے ہمیں اس ثابت نصف سائیکل کے دوران ایک برآمدہ کرنٹ ملتا ہے (اور لوڈ مزاحمت R_L کے سروں کے درمیان ایک برآمدہ دو لیٹچ)، جیسا کہ شکل 14.19 (c) میں دکھایا گیا ہے۔ سائیکل کے دوران جب A پر دو لیٹچ مرکزی کھکھے کی مناسبت سے منفی ہو جاتی ہے تو B پر دو لیٹچ ثابت ہو گی۔ سائیکل کے اس حصے میں ڈائیوڈ D_1 ایصال نہیں کرے گا، لیکن ڈائیوڈ D_2 کرے گا اور ac درآمدہ کے منفی نصف سائیکل کے دوران ایک برآمدہ کرنٹ اور برآمدہ دو لیٹچ (R_L کے سروں کے درمیان) دے گا۔ اس لیے ہمیں سائیکل کے شبت اور منفی دونوں نصف حصوں کے دوران برآمدہ دو لیٹچ ملے گی۔ ظاہر ہے کہ نصف لہر سمت کار کے مقابله میں یہ سرکٹ، سمتی دو لیٹچ یا کرنٹ حاصل کرنے کے لیے، زیادہ مستعد (efficient) ہے۔

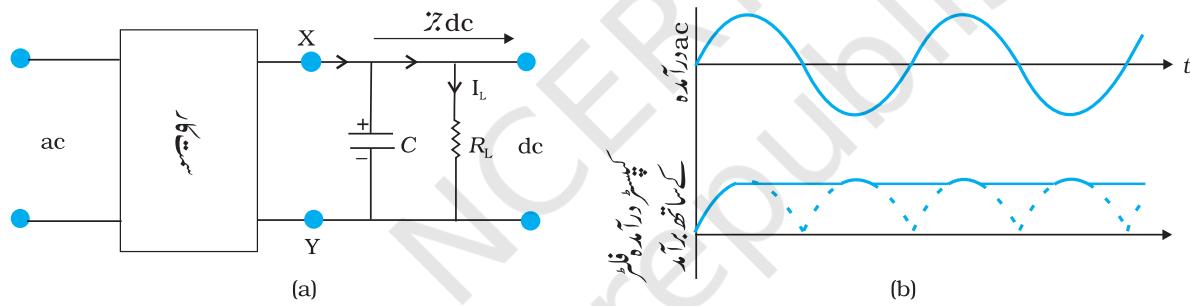
سمتی دو لیٹچ، نصف سائیکل کی شکل کی پلس کی شکل میں ہوتی ہے۔ حالاں کہ یہ یک سمتی ہوتی ہے لیکن اس کی ایک قائم تدریجی ہوتی۔ پلس کی شکل کی دو لیٹچ سے قائم dc برآمدہ حاصل کرنے کے لیے، عام طور سے برآمدہ ٹرمنلوں کے درمیان ایک پسپٹر (لوڈ R_L سے متوازی طرز میں) جوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے ہم R_L کے ساتھ، سلسلہ وار



شکل 14.19: (a) ایک مکمل۔ لہر سمت کار سرکٹ (b) ڈائیوڈ D_1 کو A پر دی گئی درآمدہ لہر شکل (c) مکمل لہر سرکٹ میں جوڑے گئے لوڈ R_L کے سروں کے درمیان برآمدہ لہر شکل

طرز میں ایک امالہ کا بھی جوڑ سکتے ہیں۔ کیوں کہ یہ اضافہ سرکٹ، ac ہلکوڑے (Ripple) کو چھانٹتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور ایک خالص dc و لیٹچ دیتے ہیں، اس لیے انھیں فلٹر کہتے ہیں۔

اب ہم چھانٹنے کے عمل میں کپسٹر کے روول سے بحث کریں گے۔ جب کپسٹر کے سروں کے درمیان و لیٹچ بڑھ رہی ہوتی ہے تو یہ چارج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بیردنی لوڈ نہ ہو تو یہ سمتی برآمدہ کی فراز و لیٹچ (Peak Voltage) پر چارج رہتا ہے۔ جب ایک لوڈ ہوتا ہے تو یہ لوڈ کے ذریعے ڈسچارج ہوتا ہے اور اس کے سروں کے درمیان و لیٹچ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سمتی برآمدہ کے اگلے نصف سائیکل میں یہ دوبارہ فراز قدر تک چارج ہو جاتا ہے۔ (شکل 14.20)۔ کپسٹر کے سروں کے درمیان و لیٹچ کے کم ہونے کی شرح، کپسٹر کی گنجائش C اور سرکٹ میں استعمال کیے گئے، مزاحمہ کی موثر مراجحت R_L کے حاصل ضرب کے مقلوب کے تابع ہوتی ہے اور اسے وقت مستقلہ کہتے ہیں۔ وقت مستقلہ کو بڑا بنانے کے لیے C کو بڑا ہونا چاہیے۔ اس لیے، کپسٹر درآمدہ فلٹروں میں بڑے کپسٹر استعمال کیے جاتے ہیں۔ کپسٹر درآمدہ فلٹروں کے استعمال کے ذریعے، حاصل ہوئی برآمدہ و لیٹچ، سمتی و لیٹچ کی فراز و لیٹچ کے نزدیک ہوتی ہے۔ اس قسم کا فلٹر سب سے زیادہ پاور سپلائی میں استعمال ہوتا ہے۔



شکل 14.20 (a) کپسٹر فلٹر کے ساتھ ایک کامل۔ لہست کار (b) a میں دکھائے گئے سمت کار کی درآمدہ اور برآمدہ و لیٹچ

14.8 مخصوص غایت پی۔ این جنکشن ڈائیوڈ (SPECIAL PURPOSE p-n JUNCTION DIODES)

اس حصے میں ہم کچھ ایسے آلات سے بحث کریں گے جو بنیادی طور پر جنکشن ڈائیوڈ ہیں لیکن مختلف استعمالات کے لیے بنائے گئے ہیں۔

14.8.1 زیز ڈائیوڈ (Zener diode)

یہ ایک مخصوص غایت نیم موصل ڈائیوڈ ہے، جس کا نام اس کے موجودی۔ زیز کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اسے تعلیل علاقہ میں پس میلان کے تحت کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اسے بطور و لیٹچ تعدیل کار (Voltage regulator) استعمال کیا جاتا ہے۔ زیز ڈائیوڈ کی علامت شکل (a) 14.21 میں دکھائی گئی ہے۔

زیز ڈائیوڈ ایک جنکشن کی p-n جانب، دونوں، کو بہت زیادہ ڈوب کر کے بنایا جاتا ہے۔ اس طرح عسرت علاقہ بہت پلا (10^{-6}m) تکمیل ہوتا ہے اور جنکشن کا برتن میدان بہت خفیف پس میلان و لیٹچ برقی پر یا 5V قدر

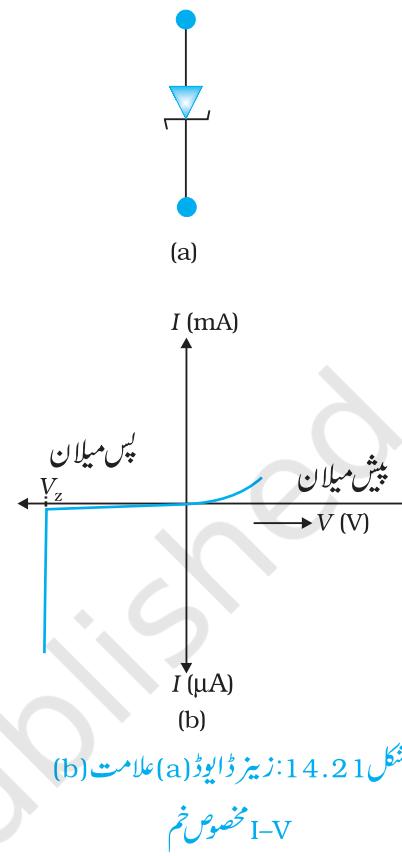
کی، کے لیے بھی بہت زیادہ $V/m \sim 5 \times 10^6$ مخصوص خم شکل

(b) 14.21 میں دکھایا گیا ہے۔ یہ دکھایا گیا ہے کہ جب لگائی گئی پس مائل ولٹچ (V)، زیر ڈائیوڈ کی تعطل ولٹچ (V_z) تک پہنچتی ہے تو پس مائل ولٹچ میں تقریباً غیر قابل لحاظ تبدیلی کے ذریعے بھی کرنٹ میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کی جاسکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں، زیر ولٹچ مستقلہ رہتی ہے، حالانکہ زیر ڈائیوڈ سے گذر رہا کرنٹ بڑی سعت پر تبدیل ہوتا ہے۔ زیر ڈائیوڈ کی یہ خاصیت سپلائی ولٹچوں کی تعديل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تاکہ وہ مستقلہ رہیں۔

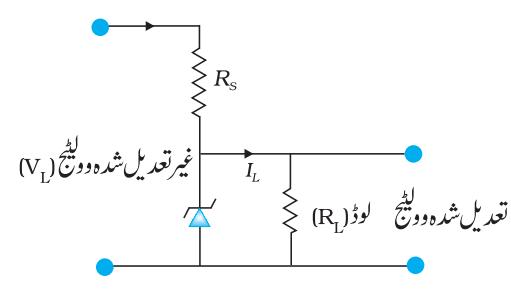
آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ تعطل ولٹچ پر پس کرنٹ اچانک کیوں بڑھ جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پس کرنٹ الیکٹرانوں (اقليتی حاملوں) کے $n \rightarrow p$ اور سوراخوں کے $p \rightarrow n$ بہنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے پس مائل ولٹچ میں اضافہ کیا جاتا ہے، جتنا پر برقی میدان قابل لحاظ ہوتا جاتا ہے۔ جب پس مائل ولٹچ (V)، V_z کے مساوی ہو جاتی ہے۔ ($V = V_z$)، تو برقی میدان کی طاقت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ میزبان ایٹموں سے گرفت الیکٹرانوں کو p -جانب کھینچ سکے جو کہ n -جانب اسراع پذیر تھے۔ یہ الیکٹران ہی تعطل پر مشاہدہ کیے گئے بڑے کرنٹ کی وجہ ہیں۔ میزبان ایٹموں سے، اعلیٰ برقی میدان کی وجہ سے، الیکٹرانوں کا اخراج، اندرونی میدان اخراج یا میدان آئین کاری کھلاتا ہے۔ میدان آئن کاری کے لیے درکار میدان $V/m \sim 10^6$ کے درجہ کا ہوتا ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ جب ایک سمت کارکی ac درآمدہ ولٹچ غیر مستقل ہوتی ہے تو اس کا سمتی برآمدہ بھی غیر مستقل ہوتی ہے۔ ایک سمت کارکی dc برا آمدہ شدہ ولٹچ سے ایک مستقل dc ولٹچ حاصل کرنے لگے یہم ایک زیر ڈائیوڈ استعمال کرتے ہیں۔ زیر ڈائیوڈ استعمال کرتے ہوئے ایک ولٹچ تعديل کارکی سرکٹ ڈائیگرام شکل 14.22 میں دکھائی گئی ہے۔

غیر تعديل شدہ dc ولٹچ (ایک سمت کارکی فلٹر کی ہوئی برآمدہ) کو ایک سلسلہ وارمزاحمہ R_s کے ذریعے زیر ڈائیوڈ سے اس طرح جوڑا جاتا ہے کہ زیر ڈائیوڈ پس مائل ہو۔ اگر درآمدہ ولٹچ بڑھتی ہے تو R_s اور زیر ڈائیوڈ سے گذرنے والا کرنٹ بھی بڑھتا ہے۔ اس سے زیر ڈائیوڈ کے سروں کے درمیان ولٹچ میں بغیر کسی تبدیلی کے R_s کے سروں کے درمیان ولٹچ بڑھ جاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے، کیوں کہ تعطل علاقہ میں، زیر ولٹچ مستقلہ رہتی ہے اور حالانکہ زیر ڈائیوڈ سے گذر رہا کرنٹ تبدیل ہوتا ہے۔ اسی طرح، اگر درآمدہ ولٹچ کم ہوتی ہے تو R_s اور زیر ڈائیوڈ سے گذرنے والا کرنٹ بھی کم ہو جاتا ہے۔ زیر ڈائیوڈ کے سروں کے درمیان ولٹچ فرق میں بغیر کسی تبدیلی کے R_s کے سروں کے درمیان ولٹچ کم ہو جاتا ہے اس اضافہ کی، زیر ڈائیوڈ کے سروں کے درمیان ولٹچ میں بغیر کوئی تبدیلی کیے، R_s کے سروں میں اضافہ کی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح زیر ڈائیوڈ ایک ولٹچ تعديل کارکی طرح کا کومٹلو بہ برآمدہ ولٹچ کے مطابق منتخب کرنا ہوتا ہے اور اسی لحاظ سے سلسلہ وارمزاحمہ R_s کو بھی



شکل 14.21: زیر ڈائیوڈ (a) علامت (b) مخصوص خم I-V



شکل 14.22: زیر ڈائیوڈ بطور ایک DC ولٹچ تعديل کار

نیم موصل الکٹرونیات: مادے، آلات اور سادہ سرکٹ

شکل 14.5

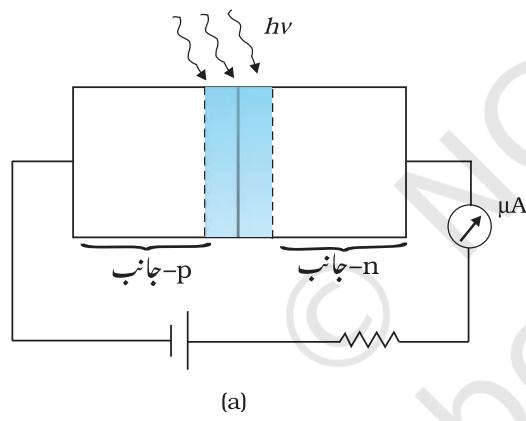
مثال 14.5: ایک زینز ڈیود میں تدبیل کاری کے لیے ایک زینز ڈیود $V_Z = 6.0 \text{ V}$ کے ساتھ، استعمال کیا جاتا ہے۔ لوڈ کرنٹ 4.0 mA ہوتا ہے اور غیر تدبیل شدہ درآمد 10.0 V ہے۔ سلسلہ وار مزاحمت R_s کی کیا قدر ہوئی چاہیے؟

حل: R_s کی قدر ایسی ہوئی چاہیے کہ زینز ڈیود سے گذرنے والا کرنٹ، لوڈ کرنٹ سے بہت زیادہ ہو۔ زینز کرنٹ کو لوڈ کرنٹ کا 5 گنا منتخب کر لیجیے، یعنی کہ: $I_Z = 20 \text{ mA}$ ، اس لیے R_s سے گذر رہا کل کرنٹ 24 mA ہے۔ R_s کے سروں کے درمیان ولٹیج فرق $V = 10.0 - 6.0 = 4.0 \text{ V}$ سے حاصل ہوتا ہے: $R_s = \frac{4.0 \text{ V}}{(24 \times 10^{-3} \text{ A})} = 167 \Omega$ ، کاربن مزاحمت کی قریب ترین قدر Ω 150 ہے۔ اس لیے 150Ω کا ایک سلسلہ وار مزاحمت مناسب ہے۔ نوٹ کریں کہ مزاحمت کی قدر میں تھوڑی بہت تبدیلی سے فرق نہیں پڑتا، اہم بات یہ ہے کہ کرنٹ I_L سے کافی زیادہ ہونا چاہیے۔

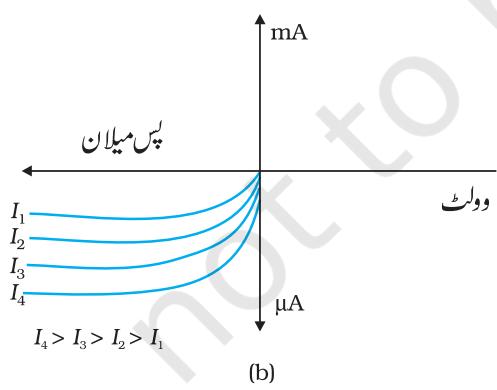
14.8.2 نوری الکٹرانک جنکشن آلات (Optoelectronic junction devices)

اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ ایک نیم موصل ڈیود، لگائی گئی برقی درآمد کے تحت کیسے برداشت کرتا ہے۔ اس حصے میں ہم ایسے نیم موصل ڈیود کے بارے میں سیکھیں گے جن میں حامل، فوٹانوں (فوٹو-اشتعال) کے ذریعے پیدا کیے جاتے ہیں۔ ایسے تمام آلات نوری الکٹرانک آلات کہلاتے ہیں۔ ہم مندرجہ ذیل نوری الکٹرانک آلات کے کام کرنے کے طریقے کا مطالعہ کریں گے:

- (i) فوٹو ڈیود (Photodiode): فوٹو ڈیود جو نوری سگنل کو شناخت کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں (فوٹو شناخت کار)۔
- (ii) روشنی خارج کرنے والے ڈیود (LED): جو برقی توانائی کو روشنی میں تبدیل کرتے ہیں۔
- (iii) فوٹو وولٹائی آلات: جو نوری اشعاع کو برق میں تبدیل کرتے ہیں (سنسی سیل)



(a)



(b)

شکل 14.23: (a) پس میلان کے تحت، ایک روشن فوٹو ڈیود (b) مختلف روشنی شدت $I_1 > I_2 > I_3 > I_4$ کے لیے ایک فوٹو ڈیود کے $I-V$ مخصوص خم

(i) **فوٹو ڈیود (Photodiode):** ایک فوٹو ڈیود بھی ایک مخصوص غایت p-n جنکشن ڈیود ہے، جسے اس طرح بنایا جاتا ہے کہ اس میں ایک شفاف کھٹکی ہوتی ہے، جس سے روشنی ڈیود پر پرستی ہے۔ اسے پس میلان کے تحت چلا�ا جاتا ہے۔ جب فوٹو ڈیود پر ایسی روشنی پڑتی ہے (فوٹان پڑتے ہیں) جس کی توانائی ($h\nu$)، نیم موصل کے توانائی فصل (E_g) سے زیادہ ہوتی ہے تو فوٹانوں کے انجداب کی وجہ سے الکٹران۔ سوراخ جوڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ڈیود کو اس طرح بنایا جاتا ہے کہ e-h جوڑے، ڈیود کے عسرت۔ علاقے میں یا اس کے نزدیک، پیدا ہوں۔ جنکشن کے برقی میدان کی وجہ سے، الکٹران اور سوراخ، باز متعدد ہونے سے پہلے ہی ایک دوسرے سے

علاحدہ ہو جاتے ہیں۔ بر قی میدان کی سمت ایسی ہوتی ہے کہ الکٹران n-جانب پہنچتے ہیں اور سوراخ p-جانب پہنچتے ہیں۔ الکٹرانوں کو n-جانب وصول کر لیا جاتا ہے اور سوراخوں کو p-جانب، جس سے ایک emf پیدا ہوتی ہے۔ جب ایک بیرونی لوڈ لگایا جاتا ہے تو کرنٹ بہتا ہے۔ فوٹوکرنٹ کی عدی قدر، واقع روشنی کی شدت کے تابع ہے (فوٹوکرنٹ، واقع روشنی کی شدت کے مقابہ ہے)

اگر ایک پس میلان لگایا جائے تو روشنی کی شدت کے ساتھ کرنٹ میں تبدیلی کا مشاہدہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک فوٹوایڈ، نوری سگنالوں کو شناخت کرنے کے لیے بطور فوٹو شناخت کار استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک فوٹوایڈ کے V-I مخصوص خم کی پیکاٹ کے لیے استعمال کی جانے والی سرکٹ ڈائیگرام شکل (a) 14.23 میں دکھائی گئی ہے اور ایک مخصوص، V-I مخصوص خم شکل (b) 14.23 میں دکھایا گیا ہے۔

مثال 14.6: پیش میلان میں کرنٹ (A_m) سے زیادہ ہوتا ہے، یہ

ہمیں معلوم ہے۔ پھر فوٹوایڈ کو پس میلان میں چلانے کی وجہ کیا ہے؟

حل: ایک n-قسم نیم موصل بیجی۔ ظاہر ہے کہ اکثریت حامل کثافت (n)، اقلیت حامل کثافت (p) سے بہت زیادہ ہے (یعنی کہ $n > p$)۔ فرض کیجیے روشن کرنے پر، پیدا ہونے والے مزید الکٹران اور سوراخ، بالترتیب، Δn اور Δp ہیں:

$$n' = n + \Delta n$$

$$p' = p + \Delta p$$

جہاں n' اور p' ایکٹرانوں اور سوراخوں کے، کسی بھی مخصوص روشنی پر، ارتکاز ہیں اور n اور p حاملوں کے ارتکاز اس وقت ہیں جب کوئی روشنی نہیں پڑ رہی ہے۔ یاد رکھیے: $\Delta n = \Delta p$ اور $n > p$ ، اس لیے اکثریت حاملوں میں کسری تبدیلی (یعنی کہ $\frac{\Delta n}{n}$ ، اقلیت حاملوں میں کسری تبدیلی (یعنی کہ $\frac{\Delta p}{p}$) کے مقابلے میں بہت کم ہوگی۔ عمومی طور پر، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقلیت حامل حاوی پس میلان کرنٹ میں نوری اثرات کی وجہ سے ہونے والی کسری تبدیلی، پیش میلان کرنٹ میں ہونے والی کسری تبدیلی کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے تاپی جاسکتی ہے۔ اس لیے روشنی کی شدت ناپنے کے لیے فوٹوایڈ کو پس میلان میں استعمال کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔

مثال 14.6

*نوٹ کریں کہ ایک $e-h$ -جوڑا بنانے کے لیے، ہم کچھ تو انائی خرچ کرتے ہیں (فوٹاشتعال، حرارتی اشتعال، وغیرہ)۔ اس لیے جب ایک الکٹران اور سوراخ دوبارہ متوجہ ہوتے ہیں تو انائی روشنی کی شکل میں (اشعاعی بازاتحاد) خارج ہوتی ہے یا حرارت کی شکل میں (غیر اشعاعی بازاتحاد) خارج ہوتی ہے۔ یہ نیم موصل اور $n-p$ -جنکشن بنانے کے طریقے پر منحصر ہے۔ LEDs بنانے کے لیے جیسے نیم موصل استعمال کیے جاتے ہیں جن میں اشعاعی اتحاد حاوی ہوتا ہے۔

نیم موصل الکٹرونیات: مادے، آلات اور سادہ سرکٹ

(iii) روشنی خارج کرنے والا ڈائوڈ (Light emitting diode)

یہ بہت زیادہ ڈاپ کیا ہوا n-p جنکشن ہوتا ہے جو پیش میلان کے تحت از خود اشعاع خارج کرتا ہے۔ ڈائیڈ پر ایک شفاف خول چڑھا دیا جاتا ہے تاکہ خارج ہوئی روشنی باہر آسکے۔

جب ڈائیڈ پیش مائل ہوتا ہے تو لائکٹران $n \rightarrow p$ (جہاں تقییتی حامل ہیں) بھیجے جاتے ہیں اور سوراخ $p \rightarrow n$ (جہاں تقییتی حامل ہیں) بھیجے جاتے ہیں۔ جنکشن سرحد پر تقییتی حاملوں کا ارتکاز، حالت توازن ارتکاز (یعنی کہ جب کوئی میلان نہ ہو) کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے جنکشن کے دونوں طرف جنکشن سرحد پر زائد تقییتی حامل ہوتے ہیں جو جنکشن کے نزدیک اکثر تقییتی حاملوں سے باز اتحاد کرتے ہیں۔ باز اتحاد ہونے پر، تو انائی فوٹانوں کی شکل میں رہا ہوتی ہے۔ ایسے فوٹان خارج ہوتے ہیں جن کی تو انائی بینڈ فصل کے مساوی یا اس سے کچھ کم ہوتی ہے۔ جب ڈائیڈ کا پیش کرنٹ خفیض ہوتا ہے، تو خارج ہونے والی روشنی کی شدت بھی خفیض ہوتی ہے۔ جیسے جیسے پیش کرنٹ میں اضافہ ہوتا ہے، روشنی کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، بیباں تک کہ شدت اپنی اعظم قدر پر پہنچ جاتی ہے۔ پیش کرنٹ میں مزید اضافہ سے روشنی کی شدت میں کمی آتی ہے۔ اس طرح مائل کیے جاتے ہیں کہ روشنی خارج کرنے کی استعداد اعظم ہو۔

ایک LED کے I-V مخصوص خم ایک Si جنکشن ڈائیڈ بھیسے ہوتے ہیں۔ لیکن دہلیز و میجین مقابلاً بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ہر رنگ کے لیے تھوڑی مختلف ہوتی ہیں۔ LEDs کی پس قطع و لیٹچ بہت کم ہوتی ہیں، تقریباً 5V، اس لیے یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ ان کے سروں کے درمیان اعلا پس و لیٹچ نہ پیدا ہوں۔

ایسے LEDs جو لال، پیلی، نارنجی، ہری اور نیلی روشنی خارج کر سکتے ہیں، تجارتی پیمانے پر دستیاب ہیں۔ بصری LEDs تیار کرنے میں استعمال ہونے والے نیم موصلوں میں کم از کم 1.8eV کا بینڈ فصل ہونا لازمی ہے۔ (بصری روشنی کی طرفی وسعت تقریباً $0.4 \mu\text{m}$ سے $0.7 \mu\text{m}$ سے ہے، یعنی کہ تقریباً 3 eV سے 1.8 eV تک) مختلف رنگوں کے LEDs بنانے کے لیے مرکب نیم موصل گلیم آرسیناٹ-فاسفارڈ (Ga_{As}_{1-x}P_x) استعمال کیا جاتا ہے۔ (E_g ~ 1.4 eV) زیریں سرخ LED بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان LEDs کا ریبوٹ کنٹرول، چوروں کے الارم نظاموں، نوری پیام رسائی وغیرہ میں بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ سفید LEDs تیار کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر لیس رج کی جا رہی ہے۔ سفید LEDs: تباہ یہ پ کی جگہ لے سکتے ہیں۔

LEDs کے عام تباہ کم پاور یہیں کے مقابلے میں مندرجہ ذیل فائدے ہیں:

(i) یہ کم و لیٹچ اور کم پاور پر کام کر سکتے ہیں

(ii) تمیزی سے عمل کرتے ہیں اور گرم ہونے کے لیے کوئی وقت نہیں لیتے

(iii) خارج ہوئی روشنی کی بینڈ چوڑائی 100 \AA سے 500 \AA ہے یا دوسرے لفظوں میں یہ تقریباً (لیکن بالکل درست طور پر نہیں) یک رنگی ہے۔

(iv) زیادہ لمبی عمر اور مضبوطی

(v) تمیزی سے آن۔ آف ہونے کی صلاحیت

(iii) سمشی سیل (Solar cell)

ایک سمشی سیل بنیادی طور پر ایک ایسا-p-n جنگشن ہے، جس پر اگر سمشی شعاعیں پڑتی ہیں تو یہ emf پیدا کرتا ہے۔ یہ اسی اصول (فوتُو ولٹائی اثر) پر کام کرتا ہے جس پر فوتُو ڈائود کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس میں کوئی بیرونی میلان نہیں لگایا جاتا اور جنگشن رقبہ کو کہیں زیادہ وسیع رکھا جاتا ہے تاکہ زیادہ سمشی شعاعیں واقع ہو سکیں، کیوں کہ ہم زیادہ پاور چاہتے ہیں۔

ایک سادہ p-n جنگشن سمشی سیل شکل 14.24 میں دکھایا گیا ہے۔

تقریباً $300\text{ }\mu\text{m}$ موٹائی کا ایک P-Si ورق (wafer) لیتے ہیں

اور اس کے اوپر ایک طرف عمل نفوذ کے ذریعے Si-n کی ایک پتی تہہ کی (0.3 μm) جہائی جاتی ہے۔ Si-P کی دوسرا جانب دھات (چچلا تماں) کی پاش کردی جاتی ہے۔ Si-n تہہ کی اوپری سطح پر دھاتی انگلی نما بر قیرہ (metal finger electrode) (یادھاتی گرڈ) کی تہہ کی ہوتی ہے۔ یہ سامنے کے تماں کے بطور کام کرتی ہے۔ دھاتی گرڈ سیل کے رقبے کا بہت ہی چھوٹا جز گھیرتی ہے (15%) تاکہ اوپر سے روشنی سیل پر واقع ہو سکے۔

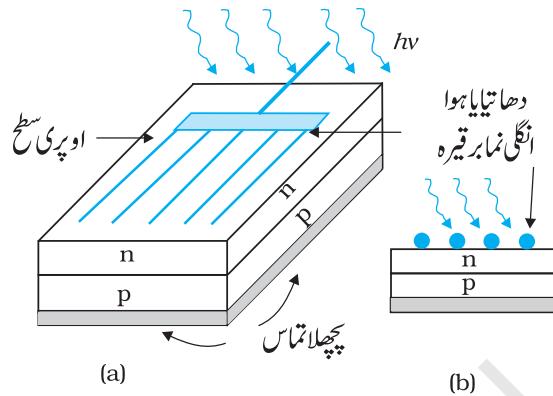
روشنی پڑنے پر، ایک سمشی سیل کے ذریعے emf پیدا ہونے میں تین بنیادی عمل شامل ہیں: پیدا ہونا، علاحدہ ہونا اور جمع کیا جانا: (i) جنگشن کے نزدیک روشنی کی وجہ سے (e-h) $\text{h}\nu > E_g$ کے ساتھ e-h جوڑوں کا پیدا ہونا۔ (ii) عسرت۔

علاقوہ کے برتن میدان کی وجہ سے الیکٹرانوں اور سوراخوں کا علیحدہ ہو جانا۔ الکٹران n جانب ڈھیل دیے جاتے ہیں اور سوراخ p-جانب۔ (iii) جنگشن کے نزدیک روشنی کی وجہ سے الیکٹران سامنے کے تماں کے ذریعے اکٹھے کر لیے جاتے ہیں اور p-جانب پہنچنے والے سوراخ چھکھے تماں کے ذریعے اس لیے p-جانب ثابت ہو جاتی ہے اور n-جانب منقی اور فوتُو ولٹیج پیدا ہوتی ہے۔

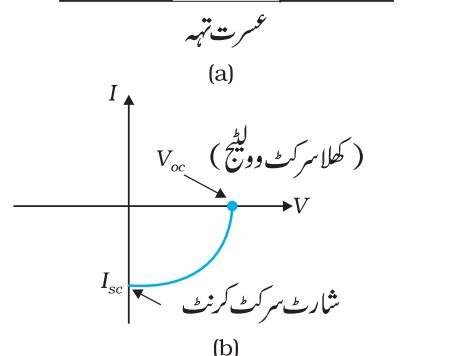
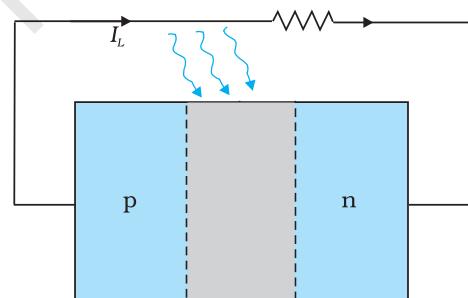
جب ایک یہ ولٹیج پیدا کرتا ہے، جیسا کہ شکل (a) 14.25 میں دکھایا گیا ہے، تو ولٹیج سے ایک فوتُو کرنٹ I_L بہتا ہے۔ ایک سمشی سیل کا مخصوص خم شکل (b) 14.25 میں دکھایا گیا ہے۔

نوٹ کریں کہ ایک سمشی سیل کا مخصوص خم، کو آرڈی نیٹ محوروں کے چوتھے ربع (quadrant) میں کھینچا گیا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہوں کہ سمشی سیل خود کرنٹ نہیں کھینچتا بلکہ لوڈ کرنٹ مہیا کرتا ہے۔

سمشی سیل بنانے کے لیے ایسے نہیں موصول، جن کے تو انائی فصل 1.5 eV کے آس پاس ہوں، مثلاً مادی اشیا ہیں۔ سمشی سیل، Si، GaAs، ($E_g = 1.1\text{ eV}$) CuInSe₂, ($E_g = 1.45\text{ eV}$) CdTe, ($E_g = 1.43\text{ eV}$) وغیرہ جیسے نہیں موصولوں سے بنائے جاتے ہیں۔ سمشی سیل بنانے کے لیے منتخب کیے جانے والی مادی شے کی اہمیت خاصیتیں ہیں: (i) بینڈ فصل (1.0 ~) سے



شکل 14.24: (a) مخصوص p-n جنگشن سمشی سیل (b) تراشہ شکل

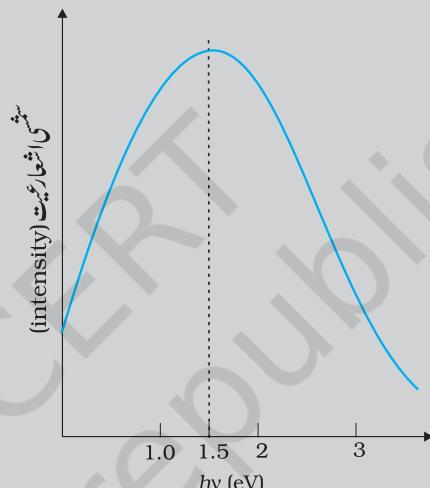


شکل 14.25: (a) ایک مخصوص روشن-p-n جنگشن سیل (b) ایک سمشی سیل کا مخصوص خم

1.8 eV)، اعلیٰ نوری انجداب ($\sim 10^4 \text{ cm}^{-1}$) برقی ایصالیت (iv) خام مادی شے کی فراہمی اور (v) قیمت نوٹ کریں کہ ایک سمشی سیل کے لیے ہمیشہ ہی سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی بھی روشنی جس کی فوٹان تو انی بیند فصل سے زیادہ ہو، کام کرے گی۔ سمشی سیل، خلائی گاڑیوں اور سیارچوں میں لگے الکٹرونک آلات کو پاور مہیا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور کچھ تحسیب کاروں (Calculators) میں بطور پاور سپلائی بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر، سمشی تو انی کے لیے کم قیمت فوٹو ولٹائی سیل تیار کرنا ریسرچ کا ایک موضوع ہے۔

مثال 14.7: سمشی سیل بنانے کے لیے Si اور GaAs مادی اشیا کو ترجیح کیوں دی جاتی ہے؟

حل: ہمیں جو سمشی اشعاع طیف متاتا ہے، اسے شکل 14.26 میں دکھایا گیا ہے۔



شکل 14.26

اس کی اعظم قدر 1.5 eV کے قریب ہے۔ فوٹو اشتغال کے لیے $h\nu > E_g$ ، اس لیے ایسا نیم موصل جس کا بیند فصل 1.5 eV یا اس سے کم ہو، اس کی سمشی تبادلہ استعداد بہتر ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ سلی کون کے لیے تو انی فصل $E_g \sim 1.1 \text{ eV}$ ہے اور GaAs کے لیے: $E_g \sim 1.53 \text{ eV}$ دراصل سے سیل GaAs زیادہ بہتر ہے (اپنے تو انی فصل کے مقابلہ زیادہ ہونے کے باوجود) کیوں کہ اس کا انجداب ضربیہ مقابلہ زیادہ ہے۔ اگر CdS یا CdSe کی $E_g \sim 2.4 \text{ eV}$ منتخب کریں تو ہم نوری تبادلے کے لیے سمشی تو انی کا اعلاء تو انی جز ہی استعمال کر سکتے ہیں اور تو انی کا ایک قبل الحاظ حصہ کامنیں آسکے گا۔

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے: ہم PbS ($E_g \sim 0.4 \text{ eV}$) جیسی مادی شے کیوں نہیں استعمال کرتے جو سمشی اشعاع کے مطابق، $h\nu$ کی اعظم قدر کے لیے E_g کی شرط کو مطمئن کرتی ہے؟ اگر ہم ایسا کریں تو سمشی شعاعوں کا زیادہ تر حصہ سمشی سیل کی بالائی سطح پر ہی جذب ہو جائے گا اور عسرت علاقہ میں ایسا کے نزدیک نہیں پہنچ گا۔ جنکشن میدان کی وجہ سے موثر الکٹران۔ سوراخ علاحدگی کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ فوٹو۔ پیداوار صرف جنکشن علاقے میں ہی ہو۔

14.9 ہندسی الکٹرونیات اور لو جک گیٹس

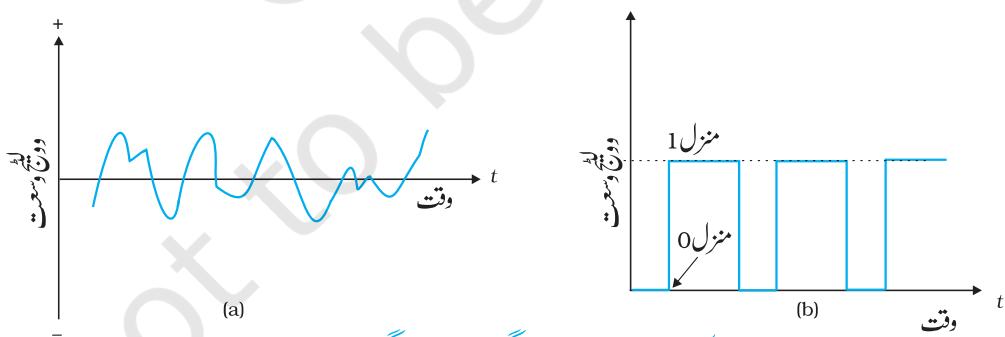
(DIGITAL ELECTRONICS AND LOGIC GATES)

الکٹرونیاتی سر کٹوں، جیسے افزائش کاروں، اہتزاز کاروں، میں، جن سے آپ کا پچھلے حصوں میں تعارف کیا گیا ہے، سگنل (کرنٹ یا ولٹیج) کو، مسلسل، وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہوئی ولٹیج یا کرنٹ کی شکل میں لیا گیا تھا۔ ایسے سگنلوں کو مسلسل یا مشابہ (analogue) سگنل کہتے ہیں۔ ایک مخصوص مشابہ سگنل شکل 14.27(a) میں دکھایا گیا ہے۔ شکل 14.27(b) میں ایک پلس اہر شکل (pulse wave form) دکھائی گئی ہے، جس میں ولٹیج کی صرف مجرد قدریں (discrete values) ہی دکھائی گئی ہیں۔ ایسے سگنلوں کو ظاہر کرنے کے لیے ثانی اعداد (binary numbers) استعمال کرنے سے ہویت رہتی ہے۔ ایک ثانی ا عدد میں صرف دو ہندسے، 0، (فرض کیجیے 0V) اور 1، (فرض کیجیے 5V) ہوتے ہیں۔

ہندسی الکٹرونیات میں ہم ولٹیج کی صرف یہ دو منزلیں (levels) ہی استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ شکل 14.27(b) میں دکھایا گیا ہے۔ ایسے سگنل، ہندسی سگنل کہلاتے ہیں۔ ہندسی سر کٹوں میں درآمدہ اور برآمدہ ولٹیجوں کی صرف دو قدریں (جو 0 اور 1 سے ظاہر کی جاتی ہیں) ہی استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔

اس حصہ کو ہندسی الکٹرونیات کی تفہیم میں پہلا قدم مہیا کرنے کی غرض سے لکھا گیا ہے۔ ہم اپنے مطالعہ کو ہندسی الکٹرونیات کے کچھ بنیادی تعمیراتی اجزا تک ہی محدود رکھیں گے (لو جک گیٹس کہلاتے ہیں)، جو ہندسی سگنلوں کو ایک خاص طریقے سے بر تے ہیں۔ لو جک گیٹس، تحسیب کاروں، ہندسی گھڑیوں، کمپیوٹروں، رو بلوں، صنعتی کنٹرول نظاموں اور ٹیلی پیام رسائی (Telecommunication) میں استعمال ہوتے ہیں۔

آپ کے گھر کار و شنی سوچ ایک ہندسی سر کٹ کی مثال ہے۔ روشنی یا تو آن ہوتی ہے یا آف، جو سوچ کی حالت پر منحصر ہے۔ جب روشنی آن ہے تو برآمدہ قدر 1 ہے۔ جب روشنی آف ہے تو برآمدہ قدر 0 ہے۔ برآمدات، روشنی سوچ کی حالتیں ہیں۔ سوچ کو on یا off میں سے کسی ایک حالت میں رکھا جاتا ہے اور اس طرح روشنی کو فعال بنا یا جاتا ہے۔

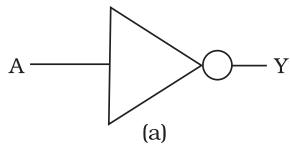


شکل 14.23: (a) مشابہ سگنل (b) ہندسی سگنل

14.9.1 لو جک گیٹس (Logic gates)

ایک گیٹ ایسا ہندسی سر کٹ ہے جو درآمدہ اور برآمدہ ولٹیجوں کے درمیان ایک منطقی رشتہ پر عمل کرتا ہے۔ اس لیے انہیں عموماً لو جک گیٹس کہا جاتا ہے۔ گیٹ اس لیے کیوں کہ یہ اطلاعات کے بہاؤ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ استعمال کیے جانے

نیم موصل الکٹرونیات: مادے، آلات اور سادہ سرکٹ



برآمدہ	درآمدہ
Y	A
1	0
0	1

(b)

شکل 14.28: NOT گیٹ (a) کی

لو جک علامت (b) کا صداقتی جدول

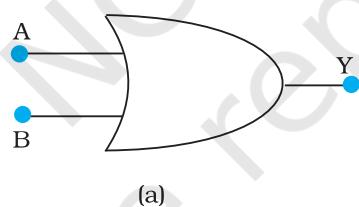
والے 5 عام گیٹ ہیں: NOT, NOR, OR, AND, NAND۔ ہر لو جک گیٹ کی ایک علامت کے ذریعے نشان دہی کی جاتی ہے اور اس کی کارکردگی کی تعریف ایک صداقتی جدول کے ذریعے کی جاتی ہے جو تمام ممکنہ درآمدہ لو جک منزل اجتماعات کو ان کے مطابق برآمدہ لو جک منازل کے ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ صداقتی جدول لو جک گیٹوں کے برداشت کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ لو جک گیٹ، نیم موصل آلات استعمال کر کے بنائے جاسکتے ہیں۔

(i) نات گیٹ (NOT Gate)

یہ سب سے بنیادی گیٹ ہے، جس میں ایک درآمدہ اور ایک برآمدہ ہوتا ہے۔ جب درآمدہ '0' ہوتا ہے تو یہ '1' برآمدہ دیتا ہے اور اس کے برخلاف بھی۔ یعنی کہ یہ اپنے برآمدہ کے بطور درآمدہ کی ایک تقلیب شدہ (الٹی) شکل پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اسے تقلیب کار (inverter) کہتے ہیں۔ اس گیٹ کے لیے عام طور سے استعمال کی جانے والی علامت اور اس کا صداقتی جدول شکل 14.28 میں دکھایا گیا ہے۔

(ii) آر گیٹ (OR Gate)

ایک OR گیٹ میں دو درآمدات اور ایک برآمدہ ہوتے ہیں۔ اس کی لو جک علامت اور صداقتی جدول شکل 14.29 میں دکھائی گئی ہیں۔ برآمدہ Y، 1 ہوتا ہے جب درآمدہ A یا درآمدہ B یا دونوں 1 ہوں، یعنی کہ جب دونوں در مدار میں سے کوئی بھی اعلاء ہو تو برآمدہ اعلاء ہوتا ہے۔



برآمدہ	درآمدہ	
Y	B	A
0	0	0
1	1	0
1	0	1
1	1	1

(b)

شکل 14.29: OR گیٹ (a) کی لو جک علامت (b) کا صداقتی جدول

مندرجہ بالا ریاضیاتی لو جک عمل کرنے کے علاوہ یہ گیٹ پس اہر شکل میں ترمیم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل مثال سے وضاحت کی گئی ہے۔

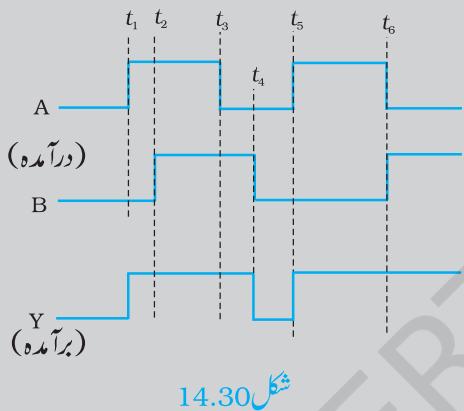
مثال 14.8: شکل 14.30 میں دیے گئے OR گیٹ کے مندرجہ ذیل درآمدات A اور B کے لیے برآمدہ لہر شکل (Y) کو درست ثابت کیجیے۔

حل: مندرجہ ذیل نوٹ کیجیے:

- $Y = 0$ لیے جیسے $A = 0, B = 0$ پر $t < t_1$
- $Y = 1$ لیے جیسے $A = 1, B = 0$ تک کے لیے $t_1 \leq t \leq t_2$
- $Y = 1$ لیے جیسے $A = 1, B = 1$ تک کے لیے $t_2 \leq t \leq t_3$

- | | | | |
|---------|------------------|-------------------------|---|
| $Y = 1$ | : $A = 0, B = 1$ | : $t_4 \leq t \leq t_3$ | • |
| $Y = 0$ | : $A = 0, B = 0$ | : $t_5 \leq t \leq t_4$ | • |
| $Y = 1$ | : $A = 1, B = 0$ | : $t_6 \leq t \leq t_5$ | • |
| $Y = 1$ | : $A = 0, B = 1$ | : $t > t_6$ | • |

اس لیے ہر شکل، شکل 14.30 میں دکھائی گئی جیسی ہوگی۔

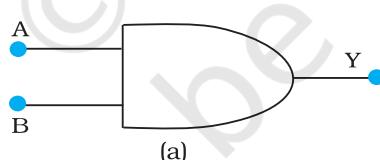


شکل 14.30

مثال 14.8

(AND Gate) (iii)

ایک AND گیٹ میں دو یا اس سے زیادہ درآمدات ہوتے ہیں اور ایک برآمدہ ہوتا ہے۔ AND گیٹ کا برآمدہ Y صرف تب ہی 1 ہوتا ہے جب درآمدہ A اور درآمدہ B دونوں '1' ہوں۔ اس گیٹ کے لیے لوچک علامت اور صدقتنی جدول شکل 14.31 میں دکھائے گئے ہیں۔



شکل 14.31: گیٹ (a) کی لوچک علامت (b) کا صدقتنی جدول

برآمدہ		درآمدہ	
Y	B	A	
0	0	0	
1	1	0	
1	0	1	
1	1	1	

(b)

مثال 14.9: مثال 14.8 سے مشابہ A اور B درآمدہ ہر شکل میں بجیے۔ AND گیٹ سے حاصل ہونے والی برآمدہ ہر شکل کا خاکہ کچھ پیچے۔

حل:

- | | | | |
|---------|------------------|-------------------------|---|
| $Y = 0$ | : $A = 0, B = 0$ | : $t \leq t_1$ | • |
| $Y = 0$ | : $A = 1, B = 0$ | : $t_2 \leq t \leq t_1$ | • |
| $Y = 1$ | : $A = 1, B = 1$ | : $t_3 \leq t \leq t_2$ | • |

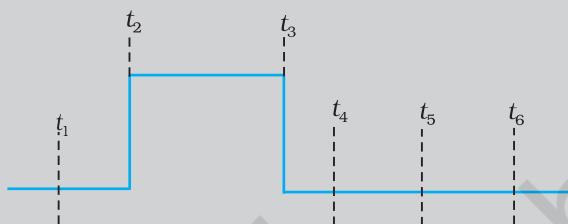
مثال 14.12

نیم موصل الکٹرونیات: مادے، آلات اور سادہ سرکٹ

شان 14.9

$Y = 0$ لیے	$A = 0, B = 1$: تک کے لیے $t_4 \leq t_3$ •
$Y = 0$ لیے	$A = 0, B = 0$: تک کے لیے $t_5 \leq t_4$ •
$Y = 0$ لیے	$A = 1, B = 0$: تک کے لیے $t_6 \leq t_5$ •
$Y = 0$ لیے	$A = 0, B = 1$: کے لیے $t > t_6$ •

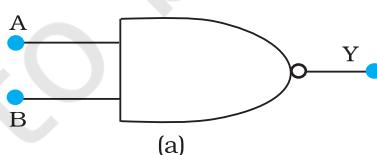
مندرجہ بالا پرمنی، AND گیٹ کے لیے اس شکل، نیچے دیے ہوئے طور پر کھینچی جاسکتی ہے۔



شکل 14.32

(iv) نانڈ گیٹ (NAND Gate)

یہ ایک AND گیٹ ہے جس کے بعد NOT گیٹ ہے۔ اگر درآمدات A اور B دونوں 1 ہیں تو برآمدہ Y نہیں ہے۔ اس کا نام اس (NOT-AND) گیٹ کی وجہ سے ہے۔ شکل 14.33 میں NAND گیٹ کی علامت اور صداقت جدول دکھائے گئے ہیں۔ NAND گیٹ، کائناقی گیٹ بھی کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کو استعمال کر کے ہم دوسرے بنیادی گیٹ جیسے OR، AND، NOT، OR-NOT، حاصل کر سکتے ہیں (مشق 14.12 اور 14.13)۔



شکل 14.33: (a) کی لوگ گیٹ (b) کا صدقافتی جدول

برآمدہ	درآمدہ	
	B	A
1	0	0
1	1	0
1	0	1
0	1	1

(b)

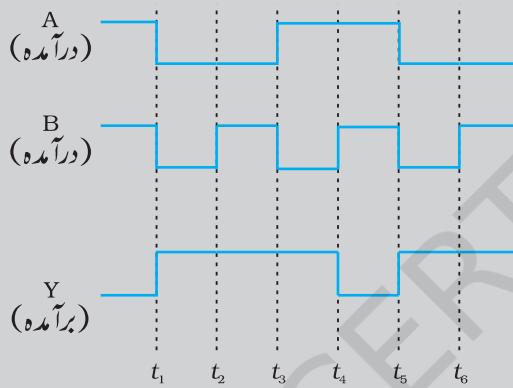
شان 14.10

مثال 14.10: مندرجہ ذیل درآمدات A اور B کے ساتھ ایک NAND گیٹ سے حاصل ہونے والے برآمدہ Y کا خاکہ کھینچے۔

حل:

$Y = 0$ لیے	$A = 1, B = 1$: کے لیے $t < t_1$ •
-------------	----------------	----------------------

$Y = 1$	$A = 0, B = 0$	تک کے لیے: $t_2 \leq t \leq t_1$
$Y = 1$	$A = 0, B = 1$	تک کے لیے: $t_3 \leq t \leq t_2$
$Y = 1$	$A = 1, B = 0$	تک کے لیے: $t_4 \leq t \leq t_3$
$Y = 0$	$A = 1, B = 1$	تک کے لیے: $t_5 \leq t \leq t_4$
$Y = 1$	$A = 0, B = 0$	تک کے لیے: $t_6 \leq t \leq t_5$
$Y = 1$	$A = 0, B = 1$	کے لیے: $t > t_6$

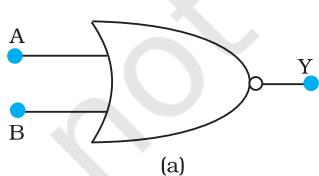


شکل 14.34

پارس
14.10

(v) نار گیٹ (NOR Gate)

اس میں دو یا دو سے زیادہ درآمدات ہوتے ہیں اور ایک برآمدہ ہوتا ہے۔ ایک NOT عمل جو OR گیٹ کے بعد لਾگو کیا جاتا ہے ایک NOT-OR گیٹ یا سادہ طور پر NOR گیٹ دیتا ہے۔ اس کا برآمدہ Y صرف تب ہی 1 ہوتا ہے جب دونوں درآمدات A اور B صفر ہوں، یعنی کہ ایک درآمدہ اور نہ ہی دوسرا درآمدہ 1 ہو۔ NOR گیٹ کے لیے علامت اور صداقت جدول شکل 14.35 میں دیے گئے ہیں۔



(a)

برآمدہ	درآمدہ	
	B	A
1	0	0
0	1	0
0	0	1
0	1	1

(b)

شکل 14.15 NOR گیٹ کے لیے (a) لوچ علامت (b) صداقت جدول

NOR گیٹ کو کائناتی گیٹ مانا جاتا ہے کیونکہ NOT، OR، AND، عیسے تمام گیٹ صرف NOR گیٹ

استعمال کر کے حاصل کیے جاسکتے ہیں (مشتق 14.14 اور مشتق 14.15)

تیز سے تیز تر اور چھوٹے چھوٹے سے چھوٹا: کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا مستقبل

(FASTER AND SMALLER: THE FUTURE OF COMPUTER TECHNOLOGY)

اجمالی چپ (IC) تمام کمپیوٹر نظاموں کے قابل پر پیوست ہے۔ دراصل ICs تقریباً تمام برتنی آلات، جیسے موڑیں، ٹیلی ویژن، CD پلیسیر، سیل فون وغیرہ، میں پائے جاتے ہیں۔ کوچک کاری (miniaturisation) جس نے جدید ذاتی کمپیوٹر کو ممکن بنایا، IC کے بغیر کبھی نہیں کی جاسکتی تھی۔ ICs وہ الکٹرونیاتی آلات ہیں جن میں کئی ٹرانسیستر، مراجع، کپسٹر، جوڑنے والے تار—سب ایک بندل (Package) میں ہوتے ہیں۔ آپ نے مائیکروپرسر کے بارے میں ضرور سننا ہوگا۔ مائیکروپرسر ایسا IC ہے جو ایک کمپیوٹر میں تمام اطلاعات پر عمل کاری کرتا ہے، جیسے کون سی کنجیاں دبائی گئی ہیں، کون سے پروگرام، کھیل وغیرہ چلائے جا رہے ہیں، ان سب کا حساب رکھنا۔ IC سب سے پہلے جیک ٹکلی نے 1958 میں ٹیکسas انسٹریومنٹ میں ایجاد کیا۔ اس ایجاد کے لیے انھیں 2000 میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ ICs ایک نیم موصلوں کے ٹکڑے (یا چپ) پر، فوٹو سنگ کاری کہے جانے والے عمل کے ذریعے، بنائے جاتے ہیں۔ اس لیے پوری اطلاعات ٹیکنالوجی (IT) نیم موصلوں پر لگی ہوئی ہے۔ پچھلے برسوں میں ICs کی پیچیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جب کہ اس پر منی کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ساتھ میں کمی آتی جا رہی ہے۔ پچھلی پانچ دہائیوں میں، کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں جو ڈرامائی کوچک کاری ہوئی ہے اس نے جدید کمپیوٹروں کو مزید تیز رفتار اور سائز میں اور چھوٹا بنادیا ہے۔ 1970 کی دہائی میں، گورڈن مور، INTEL کے بانیوں میں سے ایک، نے یہ نشان دہی کی کہ ایک چپ (IC) کی یادداشت گنجائش ہر ڈیٹھ برس کے عرصے میں تقریباً دو گنی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ عام طور سے مور کے قانون کے نام سے مقبول ہے۔ ٹرانسیستروں کی تعداد فی چپ میں قوت نمائی طور پر اضافہ ہوا ہے اور ہر سال پہلے کے مقابلے میں زیادہ طاقت ور کمپیوٹر بازار میں آجاتے ہیں اور ان کی قیمت پچھلے سال والے کمپیوٹر کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ موجودہ رہنمائی کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ 2020 میں کمپیوٹر 40GHz (40,000 MHz) پر چلیں گے اور موجودہ کمپیوٹروں کے مقابلے میں زیادہ استعداد والے، کہیں چھوٹے اور کم مہنگے ہوں گے۔ نیم موصل صنعت اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں ہونے والی دھماکہ خیز ترقی گورڈن مور کے اس قول سے بخوبی واضح ہو جاتی ہے: ”اگر موڑ گاڑیوں کی صنعت بھی اسی رفتار سے ترقی کرتی ہے، جس رفتار سے نیم موصل صنعت ترقی کر رہی ہے تو ایک روپس رائے موڑ ایک گیلن میں پانچ لاکھ میل چل سکے گی اور اسے کہیں کھڑا کرنے کا کراچی (پارکنگ) اس کی قیمت سے زیادہ ہو گا۔“

خلاصہ

- نیم موصل موجود ہوں حاصل الیکٹرائیک آلات، جیسے ڈائیوڈ، ٹرانسیستر ICs وغیرہ، میں استعمال ہونے والی بنیادی مادی اشیاء ہیں۔
- جز ترکیبی عناصر کی لیٹس ساخت اور ایٹمی ساخت یہ متعین کرتی ہیں کہ ایک مخصوص مادی شے حاصل ہوگی، دھات ہوگی یا نیم موصل ہوگی۔
- دھاتوں کی مزاجیت خفیف ہوتی ہے۔ (10^{-2} سے $10^{-8} \Omega m$ تک)، حاصلوں کی مزاجیت بہت اعلا درجے کی ہوتی ہے ($10^8 \Omega m^{-1}$) اور نیم موصلوں کی مزاجیت کی قدر ان کے درمیان ہوتی ہیں۔
- نیم موصل غضری بھی ہوتے ہیں (Si, Ge) اور مرکب بھی (CdS, GaAs وغیرہ)۔
- خالص نیم موصل ”ذاتی نیم موصل“ کہلاتے ہیں۔ چارج حاملوں (الیکٹران اور سوراخ) کی موجودگی، مادی شے کی ایک ذاتی خاصیت ہے اور یہ حرارتی اشتغال کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ ذاتی موصلوں میں الیکٹرانوں کی تعداد (n_e) سوراخوں کی تعداد (n_h) کے مساوی ہوتی ہے۔ سوراخ دراصل الیکٹران خلو ہیں، جن کا ایک موثر ثابت چارج ہوتا ہے۔
- خالص نیم موصلوں میں ایک مناسب ملاوٹ کی ڈوبپگ کر کے چارج حاملوں کی تعداد تبدیل کی جاسکتی ہے۔ ایسے نیم موصل، بیرونی نیم موصل کہلاتے ہیں۔ ان کی دو قسمیں ہیں (n-p قسم اور p-n قسم)۔
- ایک n-p قسم نیم موصل میں، $n_e >> n_h$ ، جب کہ ایک p-n قسم نیم موصل میں $n_h >> n_e$ ۔
- n-p قسم کے Si یا Ge نیم موصل، پنج گرفتی ایٹموں (عطاقاروں) جیسے As, Sb, P وغیرہ سے ڈوبپگ کر کے حاصل کیے جاتے ہیں، جب کہ p-n قسم کے Si یا Ge نیم موصل سہ گرفتی ایٹموں (حصوں) کاروں) جیسے B, Al وغیرہ سے ڈوبپگ کر کے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔
- تمام صورتوں میں: $n_i^2 = n_e n_h$ - مزید مادی شے میں مجموعی طور پر چارج تعدادیت پائی جاتی ہے۔
- تو ان ایٹموں کے دو واضح بینڈ ہوتے ہیں (جو گرفت بینڈ اور ایصال بینڈ کہلاتے ہیں)، جن میں ایک مادی شے کے الیکٹران رہتے ہیں۔ گرفت بینڈ کی تو ان ایٹماں، ایصال بینڈ کی تو ان ایٹموں کے مقابله میں کم ہوتی ہیں، ایک گرفت بینڈ کی تمام تو ان ای منازل بھری ہوتی ہیں جب کہ ایصال بینڈ میں تو ان ای منازل مکمل طور پر خالی یا جزوی طور پر بھری ہوئی ہو سکتی ہیں۔ ایصال بینڈ میں الیکٹران ہوں میں حرکت کرنے کے لیے آزاد ہوتے ہیں اور یہ ایصالیت کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ایصال بینڈ کی گرفت بینڈ کی اوپری سطح کی تو ان ایٹماں (E_v) اور ایصال بینڈ کی پچھی سطح کی تو ان ای منازل E_c کے درمیان تو ان ای منازل E_g پر مختص ہے۔

نیم موصل الکٹرونیات: مادے، آلات اور ساہہ سرکٹ

- ہے۔ گرفت بینڈ سے الکٹرانوں کو حرارت، روشنی یا بر قی توانائی کے ذریعے مشتعل کر کے ایصالی بینڈ میں پہنچایا جاسکتا ہے اور اس طرح ان کے ذریعے نیم موصل میں بہر ہے کرنٹ کو تبدیل کیا جاسکتا ہے۔
- 11- حافظوں کے لیے: $E_g > 3 \text{ eV}$, نیم موصلوں کے لیے $E_g = 0.2 \text{ eV}$ سے 3.0 eV تک ہے، جب کہ دھاتوں کے لیے $E_g = 0$ ہے۔
- 12- $p-n$ جتناش تمام نیم موصل آلات کی کنجی ہے۔ جب ایک ایسا جتناش بنایا جاتا ہے تو ایک عسرتی تہہ تشکیل پاتی ہے جو ایسے غیر متحرک آئے۔ قالبوں پر مشتمل ہوتی ہے جو اپنے الکٹرانوں یا سوراخوں سے عاری ہوتے ہیں۔ یہ جتناش پوپلیٹل روك کے لیے ذمہ دار ہے۔
- 13- بیرونی اطلاقی ولٹیج کو تبدیل کر کے جتناش روك کو تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ پیش میلان ($n-p$ -جانب بیٹری کے منفی ٹرینٹل سے منسلک ہے اور p -جانب ثابت ٹرینٹل سے منسلک ہے) میں روك کم ہو جاتی ہے جب کہ پیش میلان میں روك میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیش میلان کرنٹ زیادہ ہوتا ہے (mA)۔ جب کہ $p-n$ جتناش ڈائیڈ میں یہ بہت خفیف ہوتا ہے (μA)۔
- 14- ڈائیڈ ایک ac ولٹیج کی سمت کاری (ac ولٹیج کو ایک سمت میں مدد و رکھنا) کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ ایک کپسٹر یا مناسب فلٹر کی مدد سے ایک dc ولٹیج حاصل کی جاسکتی ہے۔
- 15- کچھ مخصوص عایت ڈائیڈ ہیں۔
- 16- زیزڈ ڈائیڈ ایسا ہی مخصوص عایت ڈائیڈ ہے۔ پیش میلان میں، ایک زیزڈ ڈائیڈ میں، ایک مخصوص ولٹیج (تطلی ولٹیج) کے بعد کرنٹ اچانک بڑھ جاتا ہے۔ یہ خاصیت ولٹیج تبدیل کاری میں استعمال کی جاتی ہے۔
- 17- $p-n$ جتناش ڈائیڈ کئی فوٹانک یا نوری۔ الکٹرانک آلات بنانے میں بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ ایسے آلات جن میں حصہ لینے والی ایک شے ”فوٹان“ ہوتی ہے۔ (a) فوٹان ڈائیڈ وہ ہوتے ہیں جن میں فوٹان اشتعال کے نتیجے میں پس سیری کرنٹ میں تبدیل ہوتی ہے جو روشنی کی شدت کی پیمائش میں مدد کرتی ہے۔ (b) سمشی سیل، جو فوٹان توانائی کو برقرار کرتے ہیں (c) روشنی خارج کرنے والے ڈائیڈ ڈائیڈ لیزر، جن میں ایک میلان ولٹیج کے ذریعے الکٹران اشتعال کے نتیجے میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔
- 18- کچھ مخصوص سرکٹ ہیں جو 0 اور 1 منازل پر منی ہندسی آنکھوں کو برقرار ہیں۔ یہ ہندسی الکٹرونیات کا موضوع ہے۔
- 19- اہم ہندسی سرکٹ جو مخصوص لوچ عمل کرتے ہیں، لوچ گیٹ کہلاتے ہیں۔ یہ ہیں، OR, NOR, AND, NAND اور NOR گیٹ۔

قابل غورنکات

- 1- نیم موصلوں میں تو انہی فصل (E_C یا E_V) فضائی مرتکنر (Space Delocalised) ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھوس میں کسی ایک خاص مقام پر مرکنر نہیں ہوتے۔ یہ تو انہیاں مجموئی اوسط ہیں۔ جب آپ کوئی ایسی تصویریں دیکھتے ہیں جن میں E_C یا E_V خطِ مستقیم کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہوتا ہے، تب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ، بالترتیب، ایصال بینڈ کی پچی سطح اور گرفت بینڈ کی بالائی سطح کی تو انہی منازل ہیں۔
- 2- عناصری نیم موصلوں (Ge یا Si) میں، $n-p$ - قسم کے نیم موصل، ڈوب کاروں (dopants) کو بے طور نقش شامل کر کے، حاصل کیے جاتے ہیں۔ مرکب نیم موصلوں میں ان کے عناصر کے آپسی تناسب پیمائی تناسبوں کو تبدیل کر کے بھی نیم موصل کی قسم کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً، ایک مثالی $As : Ga : As$ میں یہ $As : 1 : 1$ ہوتا ہے، لیکن ایک زائد As یا زائد Ga میں یہ تناسب، بالترتیب، $As_{0.9} Ga_{1.1}$ یا $As_{1.1} Ga_{0.9}$ بھی ہو سکتا ہے۔ عمومی طور پر، تقاض کی موجودگی، نیم موصل کی خاصیتوں کوئی طریقے سے کنٹرول کرتی ہے۔
- 3- ٹرانسٹروں میں، بنیاد علاقہ، پتلہ اور ہلکا ڈوب کیا ہوا ہوتا ہے۔ ورنہ درآمدہ جانب سے آرہے الیکٹران یا سوراخ (جیسے CE۔ تشاکل میں مخروج ہے) جمع کارتک نہیں پہنچ پائیں گے۔
- 4- جدید دور کے سرکٹوں میں کئی لو جک گلیوں یا سرکٹوں کو ایک واحد چپ پر اجمالي صورت میں لگا دیا جاتا ہے۔ یہ اجمالي سرکٹ (IC) کہلاتے ہیں۔

مشق

- 14.1- ایک $n-p$ - قسم سلی کون کے لیے مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے:
- الیکٹران اکثریتی حامل ہیں اور سے گرفتی ایٹم ڈوب کار ہیں۔
 - الیکٹران اقلیتی حامل ہیں اور پہنچ گرفتی ایٹم ڈوب کار ہیں۔
 - سوراخ اقلیتی حامل ہیں اور پہنچ گرفتی ایٹم ڈوب کار ہیں۔
 - سوراخ اکثریتی حامل ہیں اور سے گرفتی ایٹم ڈوب کار ہیں۔

- 14.2- مشق 14.1 میں دیے ہوئے بیانات میں سے کون سا بیان $p-n-p$ - قسم نیم موصلوں کے لیے درست ہے۔

نیم موصل الکٹرونیات: مادے، آلات اور ساواہ سرکٹ

14.3 - کاربن، سلی کون اور جمنینیم میں سے ہر ایک میں 4 گرفت الیکٹران ہوتے ہیں۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے گرفت بینڈ اور ایصال بینڈ ایک دوسرے سے تو انہی بینڈ فصل کے ذریعے عیحدہ ہوتے ہیں، جو بالترتیب کے مساوی ہوتے ہیں۔ مندرجہ ذیل بیانات میں سے کون سا بیان درست ہے:

$$(E_g)_{Si} < (E_g)_{Ge} < (E_g)_c \quad (a)$$

$$(E_g)_c < (E_g)_{Si} > (E_g)_{Ge} \quad (b)$$

$$(E_g)_c > (E_g)_{Si} > (E_g)_{Ge} \quad (c)$$

$$(E_g)_c = (E_g)_{Si} = (E_g)_{Ge} \quad (d)$$

14.4 - ایک غیر مائل p-n جتناش میں، سوراخ-p علاقے سے n- علاقے کی جانب نفوذ کرتے ہیں، کیونکہ

(a) علاقے کے آزاد الیکٹران انھیں کشش کرتے ہیں۔

(b) وہ مضمرفرق کے ذریعے جتناش سے گزرتے ہیں۔

(c) علاقے کے مقابلے میں p- علاقے میں سوراخوں کا ارتکاز زیادہ ہوتا ہے۔

(d) اوپر دیے ہوئے تمام بیانات۔

14.5 - جب ایک p-n جتناش پر پیش میلان کا اطلاق کیا جاتا ہے تو اس سے

(a) مضمر روک میں اضافہ ہوتا ہے۔

(b) اکثریتی حامل کرنٹ کم ہو کر صفر ہو جاتا ہے۔

(c) مضمر روک میں کمی آجائی ہے۔

(d) مندرجہ بالا بیانات میں سے کوئی نہیں۔

14.6 - نصف- لہر سمت کاری میں، برآمدہ تعدد کیا ہوگا، اگر درآمدہ تعدد $H_z = 50$ ہے۔ کیساں درآمدہ تعدد کے لیے

ایک مکمل- لہر سمت کار کا برآمدہ تعدد کیا ہوگا؟

14.7 - ایک p-n فوٹو ڈائڈ ایک ایسے نیم موصل سے بنایا گیا ہے، جس کا بینڈ فصل $E_g = 2.8 \text{ eV}$ ہے۔ کیا یہ 6000 nm

کی طویل لہر شناخت کر سکتا ہے؟

مزید مشق

14.8 - سلی کون ایٹموں کی تعداد $N = 10^{28} \text{ m}^{-3}$ اور انہیم کے $N = 10^{22} \text{ m}^{-3}$ ایٹموں کی تعداد کا حساب لگائیے۔

دیا ہے: $n_i = 1.5 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$ ، مادی شے-p قسم کی ہے یا n- قسم کی؟

14.9 - ایک ذاتی نیم موصل میں، تو انائی فصل $E_g = 1.2 \text{ eV}$ ہے۔ اس کی سوراخ روانی، الکٹران روانی کے مقابلے میں بہت کم ہے اور درجہ حرارت کے غیر تابع ہے۔ 600K پر ایصالیت اور 300K پر ایصالیت کے درمیان کیا نسبت ہوگی؟ فرض کر لیجیے کہ ذاتی حامل ارتکاز n_i کا درجہ حرارت انحصار دیا جاتا ہے۔

$$n_i = n_0 \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)$$

14.10 - ایک p-n جتناش ڈائوڈ میں کرنٹ کو ظاہر کیا جاسکتا ہے: $I = I_0 \exp\left(\frac{eV}{2k_B T} - 1\right)$ جہاں I_0 پس سیری کرنٹ کہلاتا ہے، V ڈائوڈ کے سروں کے درمیان ولٹیج ہے، اور I_0 ڈائوڈ میں سے گذرنے والا کرنٹ ہے، k_B بولٹر میں مستقلہ (8.6 $\times 10^{-5}$ eV/K) اور $T = 300\text{K}$ ہے۔ ایک دیے ہوئے ڈائوڈ کے

$$\text{لیے: } I_0 = 5 \times 10^{-12} \text{ A}$$

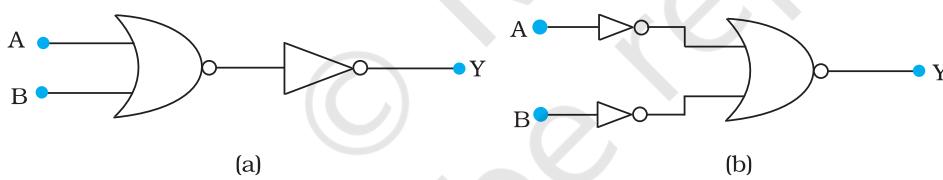
(a) پیش ولٹیج 0.6 V پر پیش کرنٹ کیا ہوگا؟

(b) اگر ڈائوڈ کے سروں کے درمیان ولٹیج بڑھا کر 0.7 V کر دیا جائے تو کرنٹ میں کیا اضافہ ہوگا؟

(c) حرکی مزاحمت کیا ہے؟

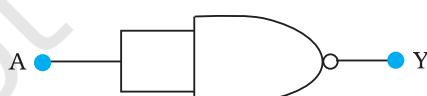
(d) اگر پس میلان ولٹیج 1 V سے بدل کر 2 V کر دی جائے تو کرنٹ کیا ہوگا؟

14.11 - آپ کو دوسرکٹ دیے گئے ہیں، جیسا کہ شکل 14.36 میں دکھایا گیا ہے۔ دکھائیے کہ سرکٹ (a) اپنے OR گیٹ کام کرتا ہے اور سرکٹ (b) AND گیٹ کے اپنے کام کرتا ہے۔



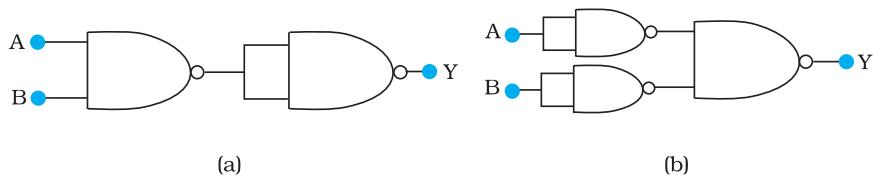
شکل 14.36

14.12 - شکل 14.37 میں دکھائے گئے طریقے سے جڑے ہوئے NAND گیٹ کے لیے صداقت جدول لکھیے۔ اور پھر اس سرکٹ کے ذریعے انجام دیے گئے لوچ عملوں کو درست طور پر شناخت کیجیے۔



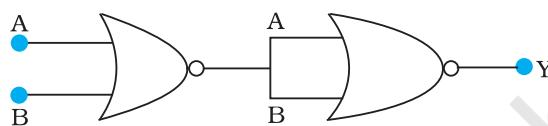
شکل 14.37

14.13 - آپ کو شکل 14.38 میں دکھائے گئے دوسرکٹ دیے گئے ہیں، جو NAND گیٹوں پر مشتمل ہیں۔ دونوں سرکٹوں کے ذریعے انجام دیے جانے والے لوچ عملوں کی شناخت کیجیے۔



14.38 شکل

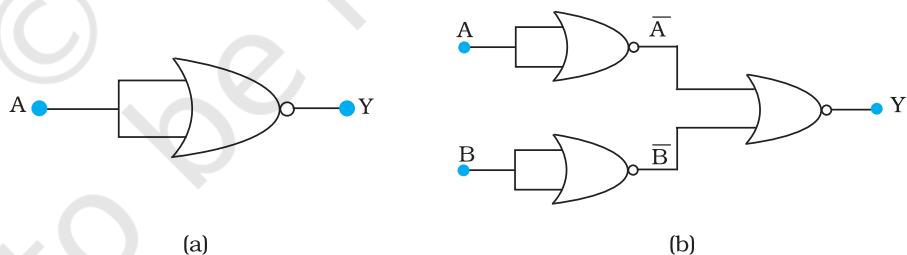
14.14 - نیچے شکل 14.39 میں دکھائے گئے سرکٹ کے لیے، صداقت جدول لکھیے، جو NOR گیٹوں پر مشتمل ہے اور یہ سرکٹ جو لو جک عمل (OR, NOT, AND) انجام دے رہا ہے۔ انھیں شاخت کیجیے۔



شکل 14.39

اشارہ: NOR گیٹ کے A اور B درآمدات 0 ہوں گے اور اس لیے $Y=1$ اسی طرح A اور B کے دیگر اجتماعات کے لیے Y کی قدریں حاصل کیجیے۔ NOT, AND, OR, NOT گیٹوں کے صداقت جدول سے مقابلہ کیجیے اور درست گیٹ معلوم کیجیے۔

- شکل 14.15 میں دیے گئے سرکٹوں کے لیے صداقت جدول لکھیے، جو NOR گیلوں پر مشتمل ہیں۔ دونوں سرکٹوں کے ذریعے انجام دیے گئے لو جک علوم (NOT AND OR) کی شاخت کیجھے۔



شکل 14.40

14.16۔ دو افزائش کار، ایک کے بعد ایک سلسلہ وار طرز میں جوڑے گئے ہیں (آبشار شدہ Cascaded)۔ پہلے افزائش کار کا ولٹیج اضافہ 10 ہے اور دوسرا کا 20 ہے۔ اگر درآمدہ سکنل 0.01V ہے تو برآمدہ ac سکنل کا حساب لگائیں۔